การพัฒนากระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไคค์ (ทัลเลียม)

นายมานิตย์ จิตรภักดี

สถาบนวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 ISBN 974-17-5172-9 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEVELOPMENT OF A SIMPLE PROCESS FOR GROWING CsI(TI) CRYSTAL

Mr. MANIT JITPUKDEE

สถาบนวิทยบริการ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Nuclear Technology Department of Nuclear Technology Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2003 ISBN 974-17-5172-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การพัฒนากระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไคค์	
	(ทັลเลียม)	
โดย	นายมานิตย์ จิตรภักดี	
สาขาวิชา	นิวเคลียร์เทค โน โลยี	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปุณณชัยยะ	
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์เคโ <mark>ช</mark> ทองอร่าม	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

...... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ คร.คิเรก ลาวัณย์ศิริ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ จันทน์ขาว)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปุณณชัยยะ) 🚽

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์เคโช ทองอร่าม)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์)

.....กรรมการ

นายมานิตย์ จิตรภักดี : การพัฒนากระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม). (DEVELOPMENT OF A SIMPLE PROCESS FOR GROWING CsI(TI) CRYSTAL) อ.ที่ปรึกษา : ผศ. สุวิทย์ ปุณณชัยยะ, อ. ที่ปรึกษาร่วม : อ. เดโช ทองอร่าม จำนวน 79 หน้า. ISBN 974-17-5172-9.

้ได้พัฒนากระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) [CsI(Tl)] ด้วย ้วิธีการปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ (Bridgman-Stockbarger) โดยใช้สารเริ่มต้นเป็นผง ซีเซียมไอโอไดด์ความบริสุทธิ์ 99.9% ผสมกับสารทัลเลียมไอโอไดด์ความบริสุทธิ์ 99.999% บรรจ ในภาชนะปลูกผลึกที่ทำด้วยแก้วไวคอร์ (Vycor) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และแขวน อยู่ในท่อปลูกผลึกระบบปิดที่ทำด้วยท่อเหล็กกล้าไร้สนิมภายใต้การอัดก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ์ 99.999% ความคัน 2 บรรยากาศ จากการทคลองแปรเปลี่ยนเงื่อนไขของสัคส่วนสาร แกรเคียนท์ ้ของอุณหภูมิ และอัตราการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึก ณ บริเวณโซนปลูกผลึกที่เหมาะสม ผลการ ปลูกผลึกพบว่า สามารถควบคุมคุณภาพของผลึกให้มีสารเจือทัลเลียมที่ความเข้มข้นอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.0256 – 0.0806 โดยโมล เมื่อนำผลึกที่ปลูกได้ประกอบกับพินโฟโตไดโอดของบริษัท Hamamatsu รุ่น S3590-8 เพื่อใช้เป็นหัววัคเรื่องรังสี สำหรับวัคสเปกตรัมพลังงานของรังสีแกมมา พบว่าผลึกซีเซียมไอโอไคค์ (ทัลเลียม) ความหนา 8 มิลลิเมตร ให้ความสามารถในการแจกแจง พลังงาน 15.48 % ที่พลังงาน 662 keV นอกจากนี้ยังทคลองใช้ผลึกที่ปลูกได้ความหนา 8 มิลลิเมตร และ 4 มิลลิเมตร ประกอบกับหลอดไวแสงชนิดทวีคูณอิเล็กตรอนของบริษัท RCA รุ่น 5819 วัคสเปกตรัมของรังสีแกมมา พบว่าให้ความสามารถในการแจกแจงพลังงาน 13.67% ที่พลังงาน 662 keV และ 34.18% ที่พลังงาน 59.6 keV ตามลำดับ ซึ่งให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผลึกที่ผลิต ในเชิงพาณิชย์

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา นิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชา นิวเคลียร์เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2546

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4370450621 : MAJOR NUCLEAR TECHNOLOGY

KEY WORD: CESIUM IODIDE CRYSTAL / CESIUM IODIDE (THALLIUM) CRYSTAL /

SCINTILLATOR / SCINTILLATION DETECTOR / CRYSTAL GROWING MANIT JITPUKDEE : DEVELOPMENT OF A SIMPLE PROCESS FOR GROWING CsI(TI) CRYSTAL. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. SUVIT PUNNACHAIYA, THESIS CO-ADVISOR: DECHO TONG-ARAM, 79 pp. ISBN 974-17-5172-9.

A CsI(Tl) scintillation crystal was grown under a simple developed process using the Bridgman-Stockbarger method. The 99.9% purity CsI powder and 99.999% purity TlI powder were mixed and charged in a 10 mm inner diameter vycor crucible. The crucible was hanged in a closed system of stainless steel growth tube under 99.999% purity pressurized Argon gas at 2 atm. By varying the experimental parameters of a mixing ratio compound elements, gradient temperature and a moving rate of growth tube. Those parameters were applied at the suitable condition of the crystal growing zone. It was found that the concentration of doped Tl in CsI growth crystal can be controlled in a range of 0.0256 – 0.0806 mol%. The developed CsI(Tl) crystal was tested by coupling with the Hamamatsu P-I-N photodiode model S3590-8, assembled as a scintillation detector, for gamma spectrum analyzing. The tested results shown an energy resolution of 13.67% at 662 keV for 8 mm thickness of CsI(Tl) crystal. Beside, the energy resolution of 13.67% at 662 keV and 34.18% at 59.6 keV were found when a growth crystal at the crystal thickness of 8 mm and 4 mm were coupled with the RCA photomultiplier tube model 5819, respectively. The results were compatible to a commercial crystal.

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department Nuclear Technology Field of study Nuclear Technology Academic year 2003

Student's signature
Advisor's signature
Co-advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปุณณชัยะ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เคโช ทอง อร่าม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการทำงานวิจัย สนับสนุน และตรวจแก้วิทยานิพนธ์ฉนับนี้จนสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และ อาจารย์นฤปวัจก์ เงินวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์ธาตุ

ขอขอบคุณ คุณบัญชา อุนพานิช ที่ให้กำแนะนำและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

้งองอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการทำงาน

สุดท้ายขอขอบคุณทบวงมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	۹
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	າ
กิติกรรมประกาศ	นิ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	សូ
สารบัญภาพ	ງີ
บทที่	

1. บทนำ

1.1 ค <mark>วามเป็นมาและความสำคัญของปัญหา</mark>	1
1.2 วัต _ิ ถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจั <mark>ย</mark>	2
1.4 ขั้นตอนและวิธีการคำเนินงานวิจัย	2
1.5 ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	2
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3

2. ทฤษฎี

		_
2.1 การบ)ลูกผลกแบบบรคจแมน-สตอกบารเกอร	5
2	2.1.1 ส่วนประกอบของระบบการปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-	
	สตีอกบาร์เกอร์	7
6161	2.1.2 กระบวนการปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์	9
2.2 ผลิกวิ	วัครั้งสีชนิคซินทิลเลชั่นประเภทสารอนินทรีย์	15
	2.2.1 การเปล่งประกายแสงของผลึกวัครังสีซินทิลเลชัน	16
2	2.2.2 คุณสมบัติที่คีของผลึกวัครังสี	19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

20	2.3 หัววัคเรื่องรังสีและพินโฟโตใคโอค
23	2.3.1 พินโฟโตใดโอค
26	2.3.2 หัววัดเรื่องรังสีชนิด CsI(Tl) พินโฟโตไดโอด

การพัฒนากระบวนการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม)

3.1 ข้อมูลพื <mark>้นฐานในการพัฒนาระบบปลูกผล</mark> ึก	30
3.2 การพัฒนาเตาปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-ส [ุ] ต็อกบาร์เกอร์	32
3.2.1 ชุดเตาหลอมแบบ 2 โซน	32
3.2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิ	34
3.2.3 ระบบบันทึกข้อมูลและเส้นกราฟอุณหภูมิ	36
3.2.4 ท่อปลูกผลึก	37
3.2. <mark>5</mark> ระบบสุญญากาศและควบคุมความดันก๊าซในท่อ	37
3.2.6 ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก	38
3.2 <mark>.7 ภาชนะปลูกผลึก</mark>	39
3.3 การออกแบบอุปกรณ์ทคสอบการต [ู] อบสนองการวัครังสีของผลึก CsI(Tl) .	40
3.3.1 การประกอบอุปกรณ์ทดลองผลึกวัดรังสี	40
3.3.2 ระบบวิเคราะห์พลังงานของรังสี	41

4. การทคลองและผลการทคลอง

4.1 การ	าทดสอบคุณลักษณะของเตาปลูกผลึก	42
	4.1.1 การทคสอบผลตอบสนองการเข้าสู่สภาวะเสถียรของอุณหภูมิ	43
	4.1.2 การทคสอบแกรเดียนท์ของอุณหภูมิ	43
4.2 การ	เทคลองปลูกผลึก	45
	4.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง	45
	4.2.2 การเตรียมสารปลูกผลึก	45
	4.2.3 การปลูกผลึกด้วยกระบวนการแบบบริดจ์แมนชนิดแนวตั้ง	46
	4.2.4 ผลการปลูกผลึก	47

สารบัญ (ต่อ)

	5	9	,	
ห	l	l	1	

49
49
51
51
52
54
55

5. สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย	

5.1 สรุปผลการวิจัย	56
5.2 วิจารณ์ผลการวิจัย	57
5.3 ข้อเสนอแนะ	57

รายการอ้างอิ่ง	59
กาลผบาก	
ภาคผนวก ก. แสดงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	61

ภาคผนวก ข. คุณสมบตของซเซยม เอ เอ เคค	66
ภาคผนวก ค. แสดงคุณสมบัติของขดลวดความร้อน	69
ภาคผนวก ง. แสดงคุณสมบัติของอิฐทนไฟ	72
ภาคผนวก จ. แสดข้อมูลอุปกรณ์ควบคุมแบบพีไอดี	73
ภาคผนวก ฉ. แสคงข้อมูลทางเทคนิคของพินโฟโตไดโอค	75
ภาคผนวก ช. การวิเคราะห์ปริมาณแทลเลียม โดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์	77
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	79

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงคุณสมบัติของผลึกซินทิลเลชันชนิดสารอนินทรีย์	16
ตารางที่ 2.2 แสคงคุณสมบัติของผลึกซีเซียมไอโอไคด์ (CsI) ชนิดต่างๆ	19
ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติการตอบสนองกวามยาวกลื่นของโฟโตไคโอคชนิคต่างๆ	22
ตารางที่ 4.1 แสคงเกรเคียนท์ของอุณหภูม <mark>ิจากกา</mark> รทคลองใช้แบฟเฟิลเส้นผ่านศูนย์กลาง	
55 มิลลิเมตร	44
ตารางที่ 4.2 ปริมาณของส่วน <mark>ผสมของส</mark> ารที่ใช้ในการปลูกผลึก	46
ตารางที่ 4.3 ผลของการปลู <mark>กผลึก CsI(T</mark> I)	48
ตารางที่ 4.4 ผลวิเคราะห์ <mark>ปริมาณสารเจือทัลเลียมในผลึก CsI(TI)</mark>	51



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ หน้า
รูปที่ 2.1 ระบบการปลูกผลึกแบบ Verneuil
รูปที่ 2.2 ระบบการปลูกผลึกเคี่ยวค้วยวิธีบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์
รูปที่ 2.3 แสดงรูปทรงภาชนะปลูกผลึกแบบต่างๆ
รูปที่ 2.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระเทียบกับรัศมีของนิวเคลียสของโลหะบริสุทธิ์10
รูปที่ 2.5 แสดงการก่อตัวแบบ Heterogeneous nucleation11
รูปที่ 2.6 การเกิดความบกพร่องของผลึกไอออนิกแบบ Schottky และ Frenkel imperfection13
รูปที่ 2.7 การเกิดความบ <mark>กพร่องแบบ D</mark> islocation14
รูปที่ 2.8 การเกิดความบกพร่องแบบ Planar defect14
รูปที่ 2.9 แสดงกลไกการเรื่องแสงของผลึกวัดรังสี17
รูปที่ 2.10 แสดงสเปกตรัมความยาวกลื่นที่ปล่อยออกมาของซินทิลเลเตอร์ชนิดสารอนินทรีย์17
รูปที่ 2.11 ตัวอย่างภาพโฟโตไคโอคชนิคต่างๆ20
รูปที่ 2.12 สเปกตรัมย่านตอบสนองความยาวคลื่นของโฟโตไดโอคชนิดต่างๆ
รูปที่ 2.13 แสคงลักษณะของพินโฟโตไดโอค24
รูปที่ 2.14 แสดงวงจรเทียบเท่าของพินโฟโตไดโอด
รูปที่ 2.15 แสดงสเปกตรัมความย <mark>าวกลื่นของผลึกวัดรัง</mark> สีเทียบกับการตอบสนองของ
พินโฟโตไคโอค26
รูปที่ 2.16 แสดงความสัมพันธ์ของความสามารถในการดูดกลื่นพลังงานของผลึก CsI
ที่ความหนาและพลังงานต่างๆ27
รูปที่ 2.17 แสดงประสิทธิภาพของวัสคุสะท้อนแสงชนิคต่างๆ
รูปที่ 2.18 การประกอบผลึกวัครั้งสีกับพินโฟโตไคโอค
รูปที่ 3.1 แผนภาพโครงสร้างของเตาปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ ที่พัฒนาขึ้น31
รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะของร่องบรรจุขดลวดความร้อนทรงกระบอกที่บรรจุขดลวดความร้อน32
รูปที่ 3.3 แสดงส่วนประกอบของชุดเตาหลอม
รูปที่ 3.4 แผนภาพวงจรควบคุมเตาหลอม
รูปที่ 3.5 แสดง โครงสร้างของเตาปลูกผลึก
รูปที่ 3.6 แผนผังการอ่านค่าอุณหภูมิ
รูปที่ 3.7 แสดงลักษณะของท่อปลูกผลึก
รูปที่ 3.8 แสดงระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก
รูปที่ 3.9 เตาปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้น

สารบัญภาพ (ต่อ)

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

หัววัครังสีชนิคซินทิลเลชัน (Scintillation detector) เป็นหัววัครังสีชนิคหนึ่งที่นำมาใช้ใน กระบวนการตรวจวัครังสีในด้านต่างๆ ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับการสร้างภาพถ่ายรังสีในอุตสาหกรรม และการแพทย์ งานตรวจวัครังสีภาคสนาม งานวิเคราะห์คุณสมบัติวัสคุด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ และระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ เป็นต้น หัววัครังสี ประเภทนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ ผลึกวัครังสีและอุปกรณ์ไวแสงชนิคหลอด ทวีคูณอิเล็กตรอน (PMT) โดยผลึกวัครังสีจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของรังสี ใน ส่วนของอุปกรณ์ไวแสงชนิคหลอดทวีคูณอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบซึ่งมีราคาสูง แตกร้าวง่าย ต้องการแรงคันไฟฟ้าไบอัสสูง ตลอดจนไวต่อการรบกวนของสนามแม่เหล็กและอุณหภูมิ จึงทำให้ มีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง

เมื่อเทคโนโลขีโฟโตนิกส์ (Photonics) ก้าวหน้าขึ้น ใคโอคไวแสงใด้รับการพัฒนาให้มี กวามไวต่อการตอบสนองแสงมากขึ้น จึงมีการนำพินโฟโตไคโอค (P-I-N Photodiode) มาใช้เป็น อุปกรณ์ไวแสงแทนหลอคทวีคูณอิเล็กตรอน เนื่องจาก มีขนาดเล็ก ไม่ไวต่อสนามแม่เหล็กรบกวน ด้องการแรงดันไบอัสต่ำ และราคาถูกกว่า ดังนั้น ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลขีจึงได้มีการ ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการปลูกผลึกวัครังสี โดยใช้สารในกลุ่ม อัลกาไลน์-เฮไลด์ (Alkaline halide) พบว่าสามารถจะปลูกผลึก CsI ได้ในห้องปฏิบัติการด้วย เครื่องมือที่ไม่ชับซ้อนมากนักและได้ปรับปรุงกุณสมบัติผลึกให้ตอบสนองการวัดรังสีเอกซ์ได้ ด้วย การเจือสารลงในผลึกครั้งแรกด้วยโซเดียม [CsI(Na)] อย่างไรก็ตามคุณสมบัติในการเกิดประกาย แสงของผลึกดังกล่าวให้ความยาวคลื่นไม่เหมาะกับพินโฟโตไดโอดและเพื่อให้งานวิจัยที่ผ่านมา เกิดความต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล จึงมีกวามสนใจที่จะพัฒนากระบวนการปลูกผลึกขึ้นใหม่ เพื่อปรับแถบพลังงาน (Energy gap) ของสารประกอบ CsI ให้กวามยาวคลื่นอยู่ในย่านความไว ของพินโฟโตไดโอค (540 nm) ด้วยการเจือสารทัลเลียมลงไป ผลึกที่จะพัฒนาขึ้นใหม่จาก กระบวนการปลูกผลึกอย่างง่ายในห้องปฏิบัติการจะเป็นผลึก CsI(TI) โดยจะทำการศึกษา พารามิเตอร์ด่างๆ ในการจัดระเบียบโครงสร้างผลึกให้เป็นผลึกเดี่ยวและการตอบสนองการวัครังสี

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการและทคลองปลูกผลึกวัครั้งสีชนิค CsI(Tl) สำหรับประกอบกับ พินโฟโตไคโอคให้เป็นหัววัครั้งสีชนิคซินทิลเลชั่นขนาคเล็ก

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- พัฒนาอุปกรณ์การปลูกผลึก CsI(TI) ด้วยวิธีของบริดจ์แมน–สต็อกบาร์เกอร์ แบบ ระบบปิดและกระบวนวิธีปลูกผลึกอย่างง่าย
- ทคลองปลูกผลึกและศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติของผลึก เช่น แกรเดียนท์ของอุณหภูมิ และความเร็วในการเคลื่อนที่ของคอลัมน์ เป็นต้น
- ทคสอบและเปรียบเทียบผลตอบสนองการวัครังสีกับหัววัครังสีชนิคเคียวกันที่ผลิตจาก ต่างประเทศ

1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัย

- 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
- 2. ศึกษาคุณสมบัติของสารเริ่มต้นและความเป็นพิษในขั้นตอนการเตรียมสาร
- พัฒนาอุปกรณ์และกระบวนวิธีปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน–สตีอกบาร์เกอร์
- 4. ทดลองปลูกผลึกและศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติของผลึก
- กคสอบและเปรียบเทียบผลตอบสนองการวัครังสีกับหัววัครังสีชนิคเคียวกันที่ผลิตจาก ต่างประเทศ
- 6. สรุปและเขียนวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ใด้กระบวนการปลูกผลึก CsI(TI) อย่างง่ายทำได้ในห้องทดลองและกระบวนการดังกล่าว ยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกผลึกวัดรังสีด้วยสารอื่นๆ อีก

1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- 1. ปี คศ. 1990 P. Schotanus, R. Kamermans และ P. Dorenbos จาก Delft University of Technology, The Netherlands ได้ศึกษาคุณสมบัติการวัดรังสีของผลึก CsI เปรียบเทียบ เมื่อเปลี่ยนความเข้มข้นของสารเจือทัลเลียมระหว่าง 0.006 ถึง 0 3 กับ CsI(Tl) เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยการวัดรังสีแกมมา 662 keV ของ ¹³⁷Cs และอนุภาคแอลฟาของ ²³⁹Pu โดยใช้หลอคไวแสงชนิดทวีคูณอิเล็กตรอน (PMT) และซิลิคอนโฟโตไดโอค (Silicon photodiode) เป็นอุปกรณ์ตรวจรับแสง พบว่าผลึก CsI บริสุทธิ์มีประสิทธิภาพ การให้แสงสูงสุด (Light yield) ที่ความยาวคลื่น 315 nm. ส่วน CsI(Tl) ให้ ประสิทธิภาพการให้แสงสงสคด้วยความยาวคลื่น 550 nm. ที่ความเข้มข้น 0.03 เปอร์เซ็นต์โมลของทัลเลียม เมื่อใช้ผลึก CsI(TI) ขนาดเส้นผ่านศนย์กลาง 18 mm. หนา 30 mm. ที่ความเข้มข้น 0.03 เปอร์เซ็นต์โมลของทัลเลียม ทคสอบด้วยรังสี แกมมาและอนุภาคแอลฟา พบว่าโฟโตใคโอคจะให้จำนวนคู่ของอิเล็กตรอนและโฮล มากกว่าโฟโตอิเล็กตรอนจากหลอคไวแสงชนิดทวีคูณ (Electron-hole pair) อิเล็กตรอน แต่ความสามารถในการแจกแจงพลังงาน (Resolution) ต่ำกว่าที่ระดับ พลังงานเดียวกัน
- ปี คศ. 2000 E. Fioretto, F. Innocenti, G. Viesti, M. Cinausero, L. Zuin, D. Fabris, M. Lunardon, G. Nebbia และ G. Prete จาก Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, Italy ได้ศึกษาผลของปริมาตรผลึกวัดรังสี CsI(TI) ขนาด 12.8 cm³, 37.5 cm³, 344.6 cm³ และ 833 cm³ ที่ใช้ร่วมกับซิลิคอนโฟโตไดโอดเพื่อตรวจสอบหา วัตถุที่สามารถระเบิดได้ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุที่สามารถระเบิดได้จะมีในโตรเจนเป็น ส่วนประกอบอยู่ ดังนั้นจึงใช้นิวตรอนพลังงานต่ำ (Thermal neutron) เข้าไปทำ อันตรกิริยากับนิวเคลียสของในโตรเจน ซึ่งจะให้รังสีแกมมาออกมา (Prompt gamma) ที่ระดับพลังงาน 10.8 MeV พบว่าเมื่อปริมาตรของผลึก CsI(TI) เพิ่มขึ้นสามารถวัด รังสีแกมมาระดับพลังงานสูงได้ดี ความสามารถในการแจกแจงพลังงานเทียบเท่าหรือ ดีกว่าผลึก NaI(TI) ที่ใช้ร่วมกับหลอดไวแสงชนิดทวีดูณอิเล็กตรอน ทั้งนี้ผลึก CsI(TI) ที่ใช้ร่วมกับซิลิคอนโฟโตไดโอดมีราคาต่ำกว่า มีความเป็นเชิงเส้นในการตอบสนอง พลังงานสูง ไม่ไวต่อการรบกวนของสนามแม่เหล็ก และมีขนาดเล็กกว่า

3. ปี พศ. 2538 วิญญู สกุลจริยาพร ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิสวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทดลองปลูกผลึก CsI(Na) ด้วยวิธีบริดจ์แมน– สต็อกบาร์เกอร์ (Bridgman–Stockbarger) โดยใช้ผงซีเซียมไอโอไดด์บริสุทธิ์เจือด้วย สารโซเดียมไอโอไดด์บริสุทธิ์ด้วยความเข้มข้น 0.2% - 0.3% โดยน้ำหนัก บรรจุใน ภาชนะปลูกผลึกทำด้วยควอทซ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มม. แขวนในท่อ เหล็กกล้าไร้สนิมในระบบปิดภายใต้ความดัน 1 บรรยากาศของก๊าซอาร์กอน พบว่า ผลึก CsI(Na) มีความใส ไม่ไวต่อความชื้นมาก ขัดผิวเรียบได้ง่าย เมื่อตัดผลึกให้มี ความหนา 2 - 3 มม. มาประกอบกับหลอดไวแสงชนิดทวีลูณอิเล็กตรอน (PMT) เพื่อ วัคสเปกตรัมของ Am-241 พบว่าความสามารถในการแจกแจงพลังงานที่ 59.6 keV อยู่ในช่วง 26% - 28% แต่เมื่อประกอบกับพินโฟโตไอโอด ประสิทธิภาพการวัดรังสี ด่ำมาก เนื่องจากความยาวคลื่นของประกายแสงไม่เหมาะสมกับความไวแสงของ พินโฟโตไดโอด

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 การปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์

ในปี 1902 Verneuil สามารถปลูกผลึกในเชิงอุตสาหกรรมด้วยวิธี Flame – Fusion Growth ได้เป็นครั้งแรก โดยปลูกผลึกเดี่ยวของทับทิม (Ruby) และ บุษราคัม (Sapphire) ที่มีจุดหลอมเหลว ประมาณ 2000°C และหลักการต่างๆ ของ Verneuil ไม่ว่าจะเป็น การก่อตัวของนิวเคลียส (Nucleation) อัตราการ โตของผลึก และวิธีการควบคุมขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของผลึก นำไปสู่ หลักการเบื้องต้นสำหรับวิธีการปลูกผลึกของ Tammann 1914, Bridgman 1923, Stöber 1925, Stockbarger 1936, Czochralski 1950 and Wilke-Bohm 1988 [1] ดังนั้น Verneuil จึงเป็นคนแรกที่ ค้นพบเทคโนโลยีการปลูกผลึก อย่างไรก็ตามระบบการปลูกผลึกแบบ Czochralski ได้รับความ นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกผลึกในกลุ่มเซมิดอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมมากที่สุด



รูปที่ 2.1 ระบบการปลูกผลึกแบบ Verneuil [1]

เทคนิคการปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ (Bridgman-Stockbarger Method) ้เป็นกระบวนการอย่างง่ายกระบวนการหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผลึกที่มีขนาดใหญ่ วิธีการ ปลูกผลึกพัฒนามาจากการปลูกผลึกเคี่ยวของ Bridgman โดยการทำให้สารหลอมเหลวแล้วปล่อยให้ เย็นตัวลงอย่างช้าๆ ภายในภาชนะบรรจุสารหลอมเหลวเมื่อปี ค.ศ. 1925 ต่อมาในปี ค.ศ. 1936 Stockbarger ทำการปรับปรุงเทคนิคการปลูกผลึกของ Bridgman โดยการเคลื่อนภาชนะที่บรรจุสาร หลอมเหลวผ่านเตาหลอมในแนวตั้ง เกิดจุดก่อตัวของผลึกที่ปลายสุดของภาชนะปลูกผลึก ซึ่งใน ้ผลึกบางชนิดอาจจำเป็นต้องใส่ผลึกเคี่ยวเริ่มต้น (Seed crystal) เพื่อทำให้เกิดผลึกได้ง่ายขึ้น ประมาณปี คศ. 1958 บริษัท Harshaw และ Semi-Element ใค้ใช้เทคนิคการปลูกผลึกแบบ บริดจ์แมน-สตีอกบาร์เกอร์ ในการปลูกผลึกซิลเวอร์เฮไลด์ (Silver halide crystal) ของ AgCl และ AgBr ในลักษณะผลึกแท่ง (Ingots) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว โดยใช้เตาหลอม แนวตั้งประกอบด้วยขดลวดกวามร้อน 2 ชุด ควบคุมอุณหภูมิให้อิสระจากกันพร้อมทั้งมีแผ่นกัน เพื่อลุดการรบกวนทางความร้อนระหว่างโซนของขุดลวดทั้งสอง ดังแสดงในรูปที่ 2.2 เตาหลอม ส่วนบนจะคงอุณหภูมิไว้ที่ 10 – 15°C เหนือจุดหลอมเหลวของซิลเวอร์เฮไลด์ (AgBr = 434°C, AgCl = 455°C) และเตาหลอมส่วนล่างคงอุณหภูมิไว้ที่ 400°C คงที่แกรเคียนท์ของอุณหภูมิ (Temperature gradient) ไว้ที่ 10°C/cm อัตราการโตของผลึก (Growth rate) อยู่ในช่วง 1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง [2]



รูปที่ 2.2 ระบบการปลูกผลึกเดี่ยวด้วยวิธีบริดจ์แมน–สตีอกบาร์เกอร์ [1]

2.1.1 ส่วนประกอบของระบบการปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์

ระบบปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน–สต็อกบาร์เกอร์ ได้พัฒนามาจากระบบปลูกผลึกแบบ บริคจ์แมนชนิคแนวตั้งคั้งเดิม (Conventional Vertical Bridgman) มีส่วนประกอบที่สำคัญดังใน รูปที่ 2.2 ดังนี้

- 1. ชุดเตาหลอมและฉนวนกันความร้อน (Baffle)
- 2. ระบบควบคุมอุณหภูมิ
- 3. ท่อปลูกผลึก
- 4. ระบบควบคุมสุญญากาศและความคันก๊าซ
- ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก
- ภาชนะปลูกผลิ๊ก

ชุดเตาหลอมปลูกผลึกมีลักษณะเป็นเตาหลอม 2 โซน แต่ละโซนคั่นด้วยฉนวนความร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนความร้อนระหว่างกัน อุณหภูมิของเตาหลอมแต่ละโซนจะควบคุม อุณหภูมิด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิอิสระจากกัน เพื่อจัดแกรเดียนท์ของอุณหภูมิให้มีโปรไฟล์ เหมาะสมกับการก่อผลึกของสาร เตาหลอมส่วนบนซึ่งเป็นชุดอุณหภูมิสูง (High temperature furnace) จะออกแบบให้สามารถทำอุณหภูมิได้เหนือระดับจุดหลอมละลายของสารที่ต้องการ ปลูกผลึก

ท่อปลูกผลึกจะต้องเลือกวัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิในการปลูกผลึก มีลักษณะเป็นท่อปลายปิด เพื่อลดผลการเคลื่อนตัวของอากาศบริเวณช่องว่างระหว่างท่อปลูกผลึกกับภาชนะปลูกผลึกและเกิด การพาความร้อน (Heat convection) อันจะกระทบต่อแกรเดียนท์ของอุณหภูมิที่จัดไว้ ขณะเดียวกัน ระบบท่อปิดสามารถสร้างความดันสุญญากาศในระดับต่างๆ ภายในท่อปลูกผลึกบางครั้งสาร ปลูกผลึกมีการระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง ยังสามารถอัดก๊าซเลื่อยให้สูงกว่าความดันบรรยากาศ ป้องกันการระเหยงองสารได้ จึงมีการออกแบบระบบควบคุมความดันสุญญากาศและความคันก๊าซ ไว้กับท่อปลูกผลึกด้วย

ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก เป็นกล ใกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะจัดอัตราการเคลื่อนที่ของ บริเวณก่อผลึกของสารในภาชนะปลูกผลึกให้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณแกรเดียนท์ของอุณหภูมิที่จัดไว้ ด้วยอัตราที่เหมาะสมกับอัตราการก่อผลึก และกล ใกในการขับเคลื่อนจะต้องออกแบบให้มีการ สั่นสะเทือนต่อภาชนะปลูกผลึกน้อยที่สุดและมีความสม่ำเสมอในการเคลื่อนที่ ซึ่งอาจเป็นระบบ pneumatic ระบบเฟืองทด หรือระบบสกรู เป็นต้น อย่างไรก็ตามในระบบปลูกผลึกขนาดเล็ก อาจจัด ให้ชุดเตาหลอมเคลื่อนที่แทนการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึก ภาชนะปลูกผลึก มักจะเลือกใช้วัสดุที่ทนต่อุณหภูมิในการปลูกผลึกและต้องไม่มีสาร แปลกปลอมที่สามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารที่ปลูกผลึก เนื่องจากผิวของภาชนะจะสัมผัส โดยตรงกับสารปลูกผลึก ขณะเดียวกัน ภาชนะปลูกผลึกในกระบวนการที่อาศัยการก่อผลึกเดี่ยวใน ตัวเอง จะต้องออกแบบมุมก้นของภาชนะให้เหมาะสมกับสารและอัตราการเคลื่อนที่ของท่อ ปลูกผลึก ซึ่งในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการออกแบบรูปทรงของปลายภาชนะปลูกผลึกในรูปแบบและ มุมที่แตกต่างกันดังในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 แสดงรูปทรงของภาชนะปลูกผลึกแบบต่างๆ [3]

2.1.2 กระบวนการปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์

การปลูกผลึกชนิดนี้อาศัยกระบวนการการหลอมสารที่จะปลูกซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะ ปลูกผลึกให้เป็นของเหลว แล้วควบคุมให้ภาชนะเคลื่อนด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับแกรเดียนท์ของ อุณหภูมิจนกระทั่งอุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว โดยผลึกเริ่มก่อตัวจากจุดปลายของภาชนะ ปลูกผลึกทำให้เกิดบริเวณรอยต่อระหว่างของแข็งและของเหลว (Solid-liquid Interface) ทฤษฎี เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกผลึกที่สำคัญ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการแข็งตัวของสสาร (Solidification) และ การก่อตัวของสสาร (Segregation) ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถควบคุมการจัดระเบียบ อะตอมในการก่อผลึกของสาร ขั้นตอนการก่อผลึกเริ่มจากในบริเวณอุณหภูมิที่พอเหมาะของสาร หลอมเหลว จะเกิดการก่อตัวของนิวไกลด์สถียร (Nucleation) จากนั้นจะเริ่มเกาะกันเป็นผลึก ด้วย อัตราการลดลงของอุณหภูมิที่ช้ามากที่บริเวณรอยต่อระหว่างของแข็งและของเหลว ทำให้เกิดการ จัดระเบียบของการยึดเกาะกันของนิวไกลด์ที่ระนาบ (Plane) เดียวกันเป็นชั้นในลักษณะผลึกเดี่ยว

ในการก่อผลึกจากสถานะของเหลวเป็นของแข็งนั้น มีพื้นฐานมาจากการก่อตัวของ นิวไคลด์ซึ่งมีกลไกการก่อตัวสองแบบ คือ Homogeneous nucleation และ Heterogeneous nucleation ของแข็งบริสุทธิ์ที่ถูกทำให้หลอมเหลวเป็นของเหลวบริสุทธิ์จะเกิดกระบวนการ Homogeneous nucleation เมื่อของเหลวถูกลดอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิแข็งตัว (Freezing temperature) ของสารหลอมเหลวนั้นๆ อย่างเพียงพอ จำนวนนิวไคล์จะก่อตัวขึ้นจากการเกิดพันธะ ของอะตอมอย่างช้าๆ หากการรวมตัวของอะตอมมีขนาดเล็กกว่าขนาดวิกฤต (Critical size) จะ เรียกว่า embryo ซึ่งจะเกิดขึ้นและสลายไปอย่างต่อเนื่อง แต่หากการรวมตัวมีขนาดใหญ่กว่าขนาด วิกฤติจะเรียกว่านิวเคลียส (Nucleus) ซึ่งมีความเสลียรและสามารถโตเป็นผลึกต่อไปได้

พลังงานที่ก่อให้เกิด Homogeneous nucleation มี 2 ส่วนด้วยกันคือ พลังงานอิสระต่อ ปริมาตร (Volume free energy) เป็นพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ของเหลวไปสู่ของแข็ง และพลังงานของพื้นผิว (Surface energy) เป็นพลังงานที่ต้องการสำหรับทำ ให้เกิดการก่อตัวของพื้นผิวใหม่บนของแข็งที่ได้ก่อตัวไปก่อนแล้ว เมื่อของเหลวถูกลดอุณหภูมิต่ำ กว่าอุณหภูมิแข็งตัว ทำให้เกิดพลังงานผลักคัน (Driving energy) ให้ของเหลวก่อตัวเป็นของแข็ง จากความแตกต่างของพลังงานอิสระต่อปริมาตร (ΔG_{v}) ของของแข็งและของเหลว ถ้าการก่อตัว ของนิวเคลียสเป็นแบบทรงกลมรัศมี r พลังงานอิสระที่เปลี่ยนแปลงต่อปริมาตรของทรงกลมจะ เท่ากับ $\frac{4}{3}\pi r^3\Delta G_v$ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระต่อปริมาตรส่างวินาดรีของ embryo หรือ นิวเคลียสแสดงในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระเทียบกับรัศมีของนิวเคลียสของโลหะบริสุทธิ์ [4]

ในทางตรงกันข้ามจะมีพลังงานที่ต้องการเพื่อทำให้เกิดการก่อตัวของพื้นผิวของ embryo หรือนิวเคลียส พลังงานสำหรับการก่อพื้นผิวทรงกลมคำนวณได้จากผลดูณของพลังงานอิสระของ พื้นผิวจำเพาะ (Specific surface free energy, γ) กับพื้นที่ผิวทรงกลม (4πr²) ดังแสดงในรูปที่ 2.4 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระรวมสำหรับการก่อตัวของ embryo หรือนิวเคลียสจึงเป็น ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระต่อปริมาณกับพลังงานอิสระของพื้นผิว ในกรณีของ เกิดการก่อตัวของ embryo หรือนิวเคลียสเป็นทรงกลมสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงของ พลังงานอิสระรวมได้จาก [4]

เมื่อ ΔG_{T} = Total free energy change

r = Radius of embryo or nucleus

 ΔG_v = Volume free energy

 γ = Specific surface free energy

จากรูปที่ 2.4 การเปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระสูงสุดเมื่อกราฟความชั้นของพลังงาน อิสระเทียบกับรัศมีเท่ากับศูนย์ ในขณะที่รัศมีการก่อตัวเท่ากับค่ารัศมีวิกฤต (r = r*) ซึ่งสามารถ คำนวณจากสมการอนุพันธ์ d(ΔG)/dr ดังนี้

โดยทั่วไปแล้วการก่อตัวของนิวเคลียสจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของภาชนะบรรจุ สารเจือที่ไม่ ละลาย หรือบนวัสดุอื่นใดก็ตามที่มีพลังงานอิสระวิกฤต (Critical free energy) ต่ำกว่าพลังงานที่ ด้องการเพื่อทำให้เกิดการก่อตัวของนิวเคลียส ดังนั้นการก่อตัวของนิวเคลียสในความเป็นจริงแล้ว จะเป็นแบบ Heterogeneous nucleation ดังรูปที่ 2.5 การก่อตัวของนิวเคลียสจะเกิดขึ้นบนตัวทำให้ เกิดการก่อตัว (Nucleating agent) และจะเกิดมุม 0 ซึ่งเป็นมุมของผิวสัมผัสระหว่างของแข็งและ ของเหลว เมื่อพลังงานพื้นผิวของ Heterogeneous nucleation ต่ำ ก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของ พลังงานอิสระรวมต่ำไปด้วย ส่งผลให้ขนาดของนิวเคลียสวิกฤตก็ต่ำไปด้วย



รูปที่ 2.5 แสดงการก่อตัวแบบ Heterogeneous nucleation [4]

เมื่อเปรียบเทียบกับสมการที่ (1) สามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระในการ ก่อตัวของนิวเคลียสได้เป็น

จากสมการ (3) การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระรวมจะมีค่าสูงสุดเมื่อ r = r* ดังนั้นถ้า r < r* การก่อตัวจะ ไม่เสถียร แต่ถ้า r > r* การก่อตัวจะเกิดสภาวะเสถียรและสามารถรวมตัวเป็นของแข็ง ได้ เมื่อแทนค่ารัศมีวิกฤติจากสมการ (2) ในสมการ (3) จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน อิสระน้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการก่อตัวเป็นของแข็งได้ โดยรัศมีและมุมของการก่อตัวคงที่ได้ดัง สมการ

อย่างไรก็ตามการโตของผลึกเดี่ยวนั้น การก่อตัวของสารจะต้องเกิดขึ้นรอบนิวเคลียสเพียง ตัวเดียวแล้วขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนเป็นระนาบผลึกเดี่ยว ซึ่งจะเกิดกรณีเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ ระหว่างของแข็งและของเหลวจะต้องต่ำกว่าจุดหลอมเหลวเล็กน้อยและอุณหภูมิของของเหลวที่อยู่ เหนือรอยต่อระหว่างของแข็งและของเหลวจะต้องสูงขึ้น ทั้งนี้ในการกวบคุมให้อุณหภูมิระหว่าง รอยต่อต่ำกว่าจุดหลอมเหลวเล็กน้อยจำเป็นต้องกวบคุมให้การโตของผลึกเกิดขึ้นอย่างช้าๆ โดย อัตราการโตของผลึกสามารถกำนวณได้จากกวามสัมพันธ์ของอัตราการสูญเสียกวามร้อนระหว่าง ผิวสัมผัสของของเหลวและผลึก ตามสมการ [5]

$$k_{s}G_{s} - k_{l}G_{l} = \rho H_{f}R \qquad(5)$$

$$k_{s}G_{s} - k_{l}G_{l} = \rho H_{f}R \qquad(5)$$

$$k_{s,l} = Thermal conductivity of the solid, liquid$$

$$G_{s,l} = Thermal gradient in the solid, liquid$$

$$\rho = Density of the solid$$

$$H_{f} = Latent heat of fusion$$

$$R = Crystal growth rate$$

การก่อผลึกในโครงสร้างของสารสามารถเกิดความไม่ต่อเนื่องของแลททิซและกลายเป็น ความบกพร่อง (Defect) บางบริเวณของโครงสร้างทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก (Crystal imperfections) โดยกลไกของการเกิดสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ ความ บกพร่องที่ไม่มีมิติ (Zero-dimension point defect) ความบกพร่องมิติเดียว (One-dimensional or line defect) และความบกพร่องสองมิติ (Two-dimensional defect)

 ก. ความบกพร่องที่ไม่มีมิติ หรือ point defect เกิดขึ้นได้ระหว่างการจัดเรียงอะตอมของ สารขณะก่อผลึกและเกิดการรบกวนด้วยผลของแรงทางประจุ ทำให้เกิดหลุมว่างขึ้นท่ามกลาง บริเวณก่อตัว เรียกว่า vacancy โดยเฉพาะกลุ่มผลึกไอออนิก ภาวะของแคทไอออน (Cation) และ แอนไอออน (Anion) จะก่อให้เกิดกลไกของความบกพร่องนี้ได้ง่าย ความบกพร่องที่รู้จักกันดีใน กลุมผลึกไอออนิก ได้แก่ Schottky imperfection และ Frenkel imperfection ดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 การเกิดความบกพร่องของผลึกไอออนิกแบบ Schottky และ Frenkel imperfection

ข. ความบกพร่องมิติเดียว หรือ Line defect เกิดขึ้นระหว่างการก่อผลึกโดยเกิดความ
 ผิดเพี้ยนของการจัดระเบียบโครงสร้างผลึก เกิดการคราดตำแหน่งและแรงเฉือนตามแนว เรียกว่า
 Dislocation มีผลให้โครงสร้างผิดเพี้ยนถาวร ดังในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 การเกิดความบกพร่องแบบ Dislocation

ค. ความบกพร่องสองมิติ หรือ Planar defect เกิดขึ้นระหว่างการเย็นตัวของสารอย่าง
 รวดเร็วและก่อผลึกในระนาบ (plane) ต่างกัน เกิดเป็น grain boundary ในสารที่เป็น polycrystal
 ดังในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 การเกิดความบกพร่องแบบ Planar defect

ผลของความไม่สมบูรณ์ของผลึก สามารถเกิดในบางบริเวณของการปลูกผลึกเดี่ยว โดยเฉพาะผลึกเดี่ยวที่ต้องการนำมาใช้เป็นผลึกวัดรังสีนั้น ความไม่สมบูรณ์ของผลึกจะมีผลโดยตรง ต่อประสิทธิภาพการเรืองรังสีของผลึก ในกรณีของ point defect จะมีผลต่อการลดปริมาณคู่ เอกซิตอน (exciton) ที่เกิดจากคู่อิเล็กตรอน-โฮล หลังการถ่ายโอนพลังงาน เนื่องจากอิเล็กตรอนจะ ถูกจับบริเวณ vacancy จึงทำให้คู่อิเล็กตรอน-โฮล ที่จะอยู่ในภาวะเอกซิตอนและเกิดการปล่อยแสง เรืองน้อยลง ส่วนในกรณีของ line defect และ planar defect จะมีผลต่อการหักเหของแสง (Refraction) และการดูดกลืนความเข้มแสง (Absorption) ทำให้แสงเรืองที่เกิดขึ้นไม่สามารถผ่าน เนื้อผลึกมายังผิวหน้าได้ดี ดังนั้น กระบวนการปลูกผลึกจึงจำเป็นต้องควบคุมพารามิเตอร์ที่มีผลต่อ การเริ่มก่อผลึกให้มีความเสถียรสูง เพื่อลดการเกิดความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก

สำหรับการปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์นั้น ตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการโตของ ผลึกคือ ลักษณะแกรเดียนท์ของอุณหภูมิและความเร็วในการเคลื่อนที่ภาชนะปลูกผลึก เนื่องจาก ตัวแปรดังกล่าวมีผลต่ออัตราการสูญเสียความร้อนระหว่างผิวสัมผัสระหว่างของเหลวและผลึก

2.2 ผลึกวัดรังสืชนิดซินทิลเลชันประเภทสารอนินทรีย์

ผลึกเรืองรังสี (Scintillation crystal) โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผลึกวัครังสีประเภท สารอินทรีย์ (Organic scintillator) ได้แก่ แอนทราซีน โพลิเมอร์ต่างๆ และผลึกวัครังสีประเภทสาร อนินทรีย์ (Inorganic scintillator) เช่น BGO, NaI(TI), CsI(TI) เป็นต้น คุณสมบัติของผลึกวัครังสี ประเภทสารอินทรีย์จะขึ้นอยู่กับลักษณะของโมเลกุล และสถานะของสารเป็นหลัก ส่วนปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเปล่งแสงของผลึกวัครังสีประเภทสารอนินทรีย์จะขึ้นกับ ปริมาณสารเงือ (Impurity – activated) และลักษณะของรูปผลึก (Crystalline) ในตารางที่ 2.1 แสดงคุณสมบัติของ ผลึกวัครังประเภทสารอนินทรีย์ชนิดต่างๆ

สถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Material	Specific Gravity	Wavelength of Maximum Emission $\lambda_{max}(nm)$	Index Of Refraction at λ_{max}	Principal Decay Constant (µS)	Pulse 10 – 90 % Rise Time (µS)	Total Light Yield (Photons per MeV)	Absolute Scintillation Efficiency for Fast Electrons (%)
NaI(Tl)	3.67	415	1.85	0.23	0.5	38,000	11.3
CsI(Tl)	4.51	540	1.80	1.00	4	52,000	11.9
CsI(Na)	4.51	420	1.84	0.63	4	39,000	11.4
LiI(Eu)	4.08	470	1.96	1.40	-	11,000	2.8
BGO	7.13	505	2.15	0.30	0.8	8,200	2.1
BaF_2 (slow)	4.89	310	1.49	0.62	3	10,000	4.5
BaF ₂ (Fast)	4.89	220	-	0.0006	-	-	-
ZnS(Ag)	4.09	450	2.36	0.2	-	-	-
CaF ₂ (Eu)	3.19	435	1.44	0.9	4	24000	6.7
CsF	4.11	390	1.48	0.004	-	-	-
Li glass ^a	2.50	<mark>39</mark> 5	1.55	0.075	-	-	1.5

ตารางที่ 2.1 แสดงคุณสมบัติของผลึกซินทิลเลชันชนิคสารอนินทรีย์ [6]

^aProperties vary with exact formulation

2.2.1 การเปล่งประกายแสงของผลึกวัครั้งสีซินทิลเลชั้น

กลไกการทำงานของผลึกวัดรังสีเริ่มจากรังสีตกกระทบผลึกวัดรังสี ก่อให้เกิดกระบวนการ ไอออไนเซชัน (Ionization) และ/หรือเอกไซเดชัน (Excitation) กระตุ้นให้อิเล็กตรอนจากแถบ วาเลนซ์ (Valance band) เคลื่อนขึ้นไปอยู่ในบริเวณใกล้แถบนำกระแส (Conduction band) เกิดกู่ ของอิเล็กตรอนและโฮลที่เหนี่ยวนำกันและกัน (Exciton) ขึ้น ปริมาณของเอกซิตอนจะขึ้นกับระดับ พลังงานที่ผลึกวัครังสีได้รับ เนื่องจากอิเล็กตรอนถูกยกระดับไปอยู่ในแถบนำกระแสจึงไม่เสถียร และต้องปลดปล่อยพลังงานออกเพื่อกลับสู่ระดับกราวนด์ (Ground state) พลังงานที่ปลดปล่อย ออกมาจะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความยาวคลื่นแสง ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การ เรืองแสง (Fluorescence) การลดระดับพลังงานของกลุ่มอิเล็กตรอนที่ถูกยกระดับพลังงานจากการ วัครังสีของผลึกวัครังสีจะให้ความเข้มของแสงเรืองในระยะเวลาสั้นมาก (≈ 10° S) จึงมีลักษณะ ของการเปล่งประกายแสง (Scintillation) และความเข้มแสงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานของ รังสีที่ผลึกวัครังสีได้รับ ความแตกต่างกันของความเข้มแสงทำให้สามารถแจกแจงพลังงานที่ แตกต่างกันของรังสีได้ ตามปกติช่องว่างของระดับพลังงาน (Energy gap) ของผลึกบริสุทธิ์จะมีระดับสูงมาก ทำให้ ความยาวคลื่นแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากผลึกอยู่ในย่านความยาวคลื่นซึ่งอุปกรณ์ไวแสง ตอบสนองได้ไม่ดี จึงมีการเติมสารเจือลงไปเล็กน้อย เรียกว่า "Activator" เพื่อทำให้เกิดความไม่ บริสุทธิ์ของผลึก และสร้างบริเวณ activator trapped ขึ้น ซึ่งมีระดับช่องว่างพลังงานต่ำกว่า การลด ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนจึงให้แสงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าดังกลไกในรูปที่ 2.9 ข. ในช่วงที่ เหมาะสมกับอุปกรณ์ไวแสง เช่น PMT หรือ โฟโตไดโอด เป็นต้น



ก. กลไกการเกิดประกายแสง

ข. กลไกการเกิดประกายแสงเมื่อเจือสาร

รูปที่ 2.9 แสดงกลไกการเรื่องแสงของผลึกวัดรังสี [1]



รูปที่ 2.10 แสดงสเปกตรัมความยาวกลื่นที่ปล่อยออกมาของซินทิลเลเตอร์ชนิดสารอนินทรีย์ [6]

ประสิทธิภาพของการเกิดประกายแสง (S_y) [7] ของผลึกสารอินทรีย์ที่เจือสารสามารถ คำนวณได้จากสมการ

$$S_{y} = \frac{E_{py}(n_{o})f_{xy}q_{oy}}{E_{wx}(n_{e})}$$
(6)

เมื่อ	S_y	=	Absolute scintillation efficiency
	E_{py}	=	Mean energy of fluorescence photon
	E _{wx}	=2	Energy loss required to produce e-h pair
	(n ₀)	=	Number of excitons
	(n _e)	=	Number of e-h produced
	f_{xy}	=	Quantum efficiency of energy transfer
	q _{oy}	=	Luminescence quantum efficiency

เนื่องจากประสิทธิภาพการเปล่งประกายแสงขึ้นกับปริมาณการเติมสารเจือลงในผลึก ดังนั้นจึงมีการศึกษาหาสมการความสัมพันธ์ของปริมาณการเติมสารเจือไว้ [6] ดังสมการ

L
$$\alpha = \frac{c(1-c)^{z}}{c + (\sigma 1/\sigma_{a})(1-c)}$$
(7)
 $d = Pulse height$
c = Mole fraction of activator
 $\sigma_{1} = Cross-section for capture of the exciton by the activator
 $\sigma_{a} = Cross-section for capture of the exciton by a lattice site
Z = Effective number of lattice sites$$

จากสมการที่ (7) จะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพการเปล่งประกายแสงของผลึกจากผลของ ปริมาณสารเจือ สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาดความสูงของสัญญาณพัลส์ (Pulse height) โดยวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานเดี่ยวของต้นกำเนิดรังสีมาตรฐานด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์หลายช่อง (MCA) และหาค่าตำแหน่งพืกพลังงานของรังสีที่แปรเปลี่ยนไปเมื่ออัตราการขยายสัญญาณกงที่ 2.2.2 คุณสมบัติที่ดีของผลึกวัดรังสี

ผลึกวัดรังสีที่ดีจะต้องให้ประสิทธิภาพในการวัดรังสีสูง ซึ่งผลึกที่จะให้ประสิทธิภาพใน การวัดรังสีสูง จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ [8]

- มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานของรังสีเป็นพลังงานแสงที่สามารถวัดได้ (High scintillator efficiency)
- 2. ความเข้มของแสงที่ให้ออกมาควรเป็นสัคส่วนโดยตรงกับพลังงานของรังสี (Linearity)
- 3. ผลึกวัครังสีจะต้องขอมให้แสงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านออกจากผลึกได้ดี (Transparent)
- 4. เวลาในการสลายแสงที่เรื่องออกมาจากผลึกสั้น (Short decay time) ทำให้สามารถ กำเนิคสัญญาณพัลส์ได้รวคเร็ว
- 5. ดัชนีหักเหของแสงควรมีค่าใกล้เคียงกับแก้ว = 1.5 (Good coupling with detector)

สารประกอบซีเซียมไอโอไคค์ (CsI) เป็นสารประกอบชนิคหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน การเป็นผลึกวัครังสี เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่ไวต่อความชื้น มีความอ่อนตัวของผลึก ไม่แตกหักง่าย ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฉับพลัน และมีความหนาแน่นสูง ผลึกวัครังสีชนิคซีเซียม ไอโอไคค์มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในลักษณะของผลึกเคี่ยวบริสุทธิ์และผลึกเคี่ยวที่เจือสาร ได้แก่ undoped CsI, CsI(Na), CsI(TI) ซึ่งมีคุณสมบัติดังตารางที่ 2.2

Type of CsI	CsI(Tl)	CsI(Na)	CsI(undoped)
Density(g/cm ³)	4.51	4.51	4.51
Melting point (K)	894	894	894
Thermal expansion coefficient (K^{-1})	$54 \ge 10^{-6}$	$49 \ge 10^{-6}$	$49 \ge 10^{-6}$
Hygroscopic de la la la de la	Slightly	Yes	Slightly
Wavelength of emission maximum(nm)	550	420	315
Lower wavelength cutoff (nm)	320	300	260
Refractive index at emission maximum	1.79	1.84	1.95
Primary decay time (µs)	1	0.63	0.016
Light yield (photon/keV)	52 - 56	38 - 44	2

ตารางที่ 2.2 แสดงกุณสมบัติของผลึกซีเซียมไอโอไคด์ (CsI) ชนิดต่างๆ [6]

2.3 หัววัดเรื่องรังสีและพินโฟโตไดโอด

หัววัดซินทิลเลชันมีกระบวนการตรวจวัดรังสีโดยทางอ้อม เมื่อผลึกเรืองรังสี (Scintillator) ใด้รับการถ่ายโอนพลังงานจะเกิดอันตรกิริยาเปล่งประกายแสง (Scintillation light) ก่อนส่งผ่านไป ยังอุปกรณ์ไวแสงซึ่งจะเปลี่ยนความเข้มของแสงไปเป็นสัญญาณพัลส์ อุปกรณ์ไวแสงที่นิยมใช้กัน มากที่สุดก็คือหลอดไวแสงชนิดทวีคูณอิเล็กตรอน (Photomultiplier tube, PMT) ซึ่งภายในจะมี โฟโตแกโทด (Photocathode) ทำหน้าที่เป็นส่วนไวแสงและชุดทวีปริมานอิเล็กตรอน (Electron multiplier) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณด้วยการทวีปริมานอิเล็กตรอน แต่หลอดไวแสงชนิดทวีคูณ อิเล็กตรอนมีข้อจำกัดบางประการที่ไม่เหมาะสมกับการวัดรังสีในสภาวะแวดล้อมบางลักษณะ เช่น บริเวณวัดรังสีมีสนามแม่เหล็กรบกวนสูง การสั่นสะเทือนสูง และในบางครั้งต้องการหัววัดที่มี งนาดเล็ก ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านโฟโตนิกส์ (Photonics) ก้าวหน้าขึ้นมาก จึงมีการผลิตไดโอด ไวแสงขึ้นมาหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณลักษณะและประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความยาว กลื่นต่างกัน โดยเฉพาะไดโอดไวแสงบางชนิดสามารถนำใช้งานร่วมกับผลึกวัดรังสีแทนหลอด ไวแสงชนิดทวีคูณอิเล็กตรอน และมีข้อดีคือ มีขนาดเล็กกว่า ไม่เกิดการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก ด้องการไบอัสแรงดันต่ำ และราคาประหยัดกว่า



รูปที่ 2.11 ตัวอย่างภาพโฟโตไดโอคชนิคต่างๆ [9]

โฟโตไดโอดมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ชนิดรอยต่อ PN เมื่อมี แสงตกกระทบที่รอยต่อจะทำให้เกิดสัญญาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าขึ้น โฟโตไดโอดเป็น ผลิตภัณฑ์จากสารกึ่งตัวนำ เช่น Si, GaAs, GaAsP และ GaP มีโครงสร้างลักษณะต่างๆ เช่น โฟโตไดโอดชนิดรอยต่อ PN (PN photodiode) พินโฟโตไดโอด (PIN photodiode) อาวาลานช์ โฟโตไดโอด (Avalanche photodiode) และโฟโตไดโอดชนิดรอยต่อชอตต์กี (Schottky photodiode) แต่ละชนิดมีกุณสมบัติและความไวต่อแสงในย่านความยาวกลื่นต่างๆ ดังเส้นกราฟในรูปที่ 2.12 และตารางที่ 2.3



รูปที่ 2.12 สเปกตรัมย่านตอบสนองความยาวคลื่นของโฟโตไคโอคชนิดต่างๆ [10]

ชนิดของโฟโตไดโอด	ช่วงตอบสนอง	ยอดสเปกตรัม	สัญลักษณ์ในรูป
	(nm)	(nm)	
โฟโตไคโอคชนิค Si	190 - 1000	720	А
	190 - 1000	960	В
	320 - 1100	960	С
	320 - 730	560	D
พินโฟโตไคโอคชนิค Si	320 - 1100	960	Е
	700 - 1100	960	F
	840 - 1100	980	G
โฟโตไดโอคชนิด GaAsP	300 - 680	640	Н
(ชนิดแพร่ซึม)	400 - 760	710	Ι
โฟโตไดโอคชนิด GaAsP	190 - 760	610	J
(ชนิคชอตต์กี)	190 - 760	710	К
โฟโตไคโอคชนิค GaP	190 - 550	440	L

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติการตอบสนองความยาวคลื่นแสงของ โฟโตไคโอคชนิคต่างๆ [10]

โดยทั่วไปแล้วโฟโตไดโอดเหล่านี้จะมีคุณสมบัติกล้ายๆ กันคือ [10]

- 1. คุณสมบัติการตอบสนองความเข้มแสงเป็นเชิงเส้นดี (Excellent linearity)
- 2. สัญญาณรบกวนต่ำ (Low noise)
- 3. ตอบสนองความยาวคลื่นแสงในช่วงกว้าง (Wide spectral response)
- 4. มีความคงทนทางกลไก (Mechanical ruggedness)
- 5. บนาคกระทัครัคและเบา (Compact and light weight)
- 6. อายุการใช้งานยาวนาน (Long life time)

จุฬาลงกรณมหาวทยาลย

2.3.1 พินโฟโตไคโอค

พินโฟโตใดโอด (P-I-N photodiode) คือโฟโตใดโอดที่มีรอยต่อชนิด P-I-N ซึ่งมี โกรงสร้างแตกต่างจากโฟโตใดโอดธรรมดาตรงที่บริเวณรอยต่อของชั้น P และ N จะมีชั้น I คั่นอยู่ แสดงในรูปที่ 2.13 ก. ชั้น I นี้หมายถึงชั้นสารกึ่งตัวนำชนิดบริสุทธิ์ (Intrinsic) ที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงทำให้พินโฟโตใดโอดมีค่าความจุไฟฟ้าของรอยต่อ (Junction capacitance) น้อยลง การ ตอบสนองด้านเวลาได้เร็วมาก (ultra – fast response speed) ถึงระดับพิโควินาที จึงมีการใช้งาน พินโฟโตใดโอดเป็นตัวตรวจจับสัญญาณอย่างแพร่หลายในระบบที่ต้องการทำงานอย่างรวดเร็ว เช่น ในระบบการสื่อสารด้วยแสงเลเซอร์ ในอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยแสง (Remote control) รวมทั้งการวัดรังสี เป็นต้น

เนื่องจากพินโฟโตไดโอดมีชั้น I อยู่ระหว่างชั้น P และ N โดยชั้น I นี้เป็นชั้นปลอดพาหะ (Depletion layer) ที่สามารถควบคุมให้มีความหนาต่างๆ ได้ตามความต้องการในระหว่าง กระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามหลักการทำงานพื้นฐานของพินโฟโตไดโอดนั้นคล้ายกับกรณี ของโฟโตไดโอดทั่วไป เมื่อมีแสงตกกระทบพินโฟโตไดโอด แสงจะทะลุผ่านชั้น P เข้าสู่ชั้น I และ N ตามลำดับ โดยแสงส่วนมากจะตกกระทบบริเวณชั้น I เนื่องจากพินโฟโตไดโอดจะออกแบบให้ ชั้น I หนากว่าชั้น P และ N มาก ถ้าพลังงานโฟตอนของแสงมีค่ามากกว่าช่องว่างพลังงานของสาร กึ่งตัวนำ (E₁) แสงก็จะถูกสารกึ่งตัวนำดูดกลืน พลังงานโฟตอนของแสงจะกระดุ้นให้อิเล็กตรอน ยกระดับจากแถบวาเลนซ์ขึ้นไปสู่แถบคอนดักชัน ส่วนแถบวาเลนซ์จะเหลือโฮลอยู่ทำให้เกิดกู่ อิเล็กตรอนและโฮลอิสระขึ้นในชั้นต่างๆ ทั้ง P, I และ N พาหะที่เกิดขึ้นจากแสงกลายเป็น กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตได้ด้วยกลไก 2 ชนิดดังนี้กือ

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ง. การลดทอนของแสงตามระยะความลึก

รูปที่ 2.13 แสดงลักษณะของพินโฟโตไดโอด


รูปที่ 2.14 แสดงวงจรเทียบเท่าของพินโฟโตไดโอด [11]

 ถ้าพาหะอิสระเหล่านี้สามารถไหลออกสู่วงจรภายนอกได้ ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า พาหะอิสระที่เกิดขึ้นในชั้น I จะมีทบบาทในการกลายเป็นกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตได้มากที่สุด โดยเฉพาะพาหะจากชั้น I จะถูกพัดพาให้ไหลออกสู่วงจรภายนอกด้วยปรากฏการณ์พัดพาด้วย ศักย์ไฟฟ้าภายใน (Built-in potential) โดยอิเล็กตรอนจะไหลออกทางชั้น N และโฮลจะไหลออก ทางชั้น P กระแสไฟฟ้าที่ได้ในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า กระแสไฟฟ้าพัดพา (Drift current)

 โฮลที่เกิดในชั้น N นั้น ถ้ามีระยะทางการแพร่ซึม (Diffusion length) ที่ใกลเพียงพอก็ จะแพร่ซึมจากชั้น N ผ่านเข้าสู่ชั้น I และใหลไปสู่ชั้น P ได้ และกลายเป็นกระแสไฟฟ้าแพร่ซึม (Diffusion current) ในทำนองเดียวกันอิเล็กตรอนที่เกิดในชั้น P ถ้ามีระยะทางการแพร่ซึมที่ใกล เพียงพอก็จะแพร่ซึมจากชั้น P เข้าสู่ชั้น I และชั้น N ได้ และจะกลายเป็นกระแสไฟฟ้าแพร่ซึมด้วย

ดังนั้นกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเป็นผลรวมของกระแสไฟฟ้าพัดพากับกระแสไฟฟ้าแพร่ซึม เมื่อพิจารณาจากวงจรเทียบเท่าของพินโฟโตไดโอดในรูปที่ 2.14 สามารถคำนวณกระแสไฟฟ้า ทั้งหมดได้จากสมการต่อไปนี้ [9]

$$I_{O} = I_{L} - I_{D} - I_{s} = I_{L} - I_{PS}(e^{ev_{D}/kT} - 1) - I_{s}$$
(8)

โดยที่	I_{PS}	=	Current generated by the incident light		
	e	=	Electron charge		
	k	=	Boltzmann's constant		
	Т	=	absolute temperature of the photodiode		

2.3.2 หัววัดเรื่องรังสีชนิด CsI(Tl) พินโฟโตไดโอด

เนื่องจากพินโฟโตไดโอดมีช่วงตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงกว้างมาก และมีพินโฟโต ใดโอดบางชนิดที่สามารถตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงในช่วงที่ตาสามารถมองเห็นได้ (Visible light) ในขณะเดียวกันผลึกวัดรังสีชนิดซินทิเลชันบางชนิด เช่น CsI(TI), BGO ให้ความยาวคลื่นแสง ในช่วงที่เหมาะสมกับการตอบสนองของพินโฟโตไดโอดดังรูปที่ 2.15 จึงทำให้สามารถใช้ พินโฟโตไดโอดเป็นอุปกรณ์ไวแสงของหัววัดเรืองรังสีได้



รูปที่ 2.15 แสดงสเปกตรัมความยาวคลื่นของผลึกวัดรังสีเทียบกับการตอบสนองของ พินโฟโตไดโอด

เพื่อให้ประสิทธิภาพของหัววัคเรืองรังสีใช้งานร่วมกับพินโฟโตไคโอคแล้วมีประสิทธิภาพ สูงสุด นอกจากจะคำนึงถึงการตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงแล้ว องค์ประกอบที่มีผลต่อการวัด รังสีที่ต้องนำมาพิจารณา ได้แก่

 การถดทอนความเข้มแสงเนื่องจากความหนาของผลึก (Light attenuation) การกำหนด ความหนาของผลึกวัดรังสีขึ้นอยู่กับช่วงพลังงานสูงสุดที่ต้องการวัดซึ่งผลึกจะต้องดูดกลืนพลังงาน ได้ทั้งหมด ถ้าความหนาของผลึกมากเกินความจำเป็นเนื้อผลึกส่วนเกินจะดูดกลืนความเข้มประกาย แสง ทำให้ประสิทธิภาพการแปล่งประกายแสงลดลง แต่ในขณะเดียวกันหากความหนาของผลึก น้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดการดูดกลืนพลังงานน้อย เนื่องจากพลังงานของรังสีจะทะลุผลึกวัดรังสี ซึ่ง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดูดกลืนพลังงานของรังสีที่พลังงานต่างๆ ของขนาด ผลึกที่ต่างกันดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 แสดงกวามสัมพันธ์ของกวามสามารถในการดูดกลืนพลังงานของผลึก CsI ที่กวามหนาและพลังงานต่างๆ [8]

2. การหักเหแสงระหว่างตัวกลาง (Refraction) ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการลดทอน กวามเข้มแสงก็คือดัชนีหักเหของแสง (Refractive index) ของผลึกซินทิลเลชัน อันเป็นผลให้แสง เกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทาง (Refraction) เมื่อแสงเดินทางจากภายในผลึกซินทิลเลชันมาถึงรอยต่อ ระหว่างผลึกซินทิลเลชันและอากาศจะเกิดการหักเหแสงขึ้น เนื่องจากมีค่าดัชนีหักเหที่แตกต่างกัน ทำให้แสงไม่สามารถส่งผ่านออกไปยังอุปกรณ์ไวแสงได้ทั้งหมด มุมที่ตกกระทบของแสงจะเป็น ส่วนสำคัญในการเกิดการสะท้อนภายในตัวเอง เมื่อมุมตกกระทบของแสงเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้เกิด การสะท้อนแสงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ในตำแหน่งที่แสงสะท้อนกลับ จนหมด ที่ตำแหน่งนี้เรียกว่ามุมวิกฤต (Critical angle,θ) มีความสัมพันธ์ดังสมการ [11]

$$θ = Sin^{-1}(\frac{1}{\mu})$$
.....(9)

μ = ดัชนีหักเหแสงของสาร

ดังนั้นในการนำผลึกซินทิเลชันมาใช้งานกับอุปกรณ์ไวแสง จำเป็นต้องใช้วัสดุประสาน รอยต่อนำแสง (Optical coupling) แทนที่ช่องว่างอากาศ โดยวัสดุประสานจะเป็นตัวช่วยลดดัชนี หักเหของแสงทำให้แสงตกกระทบผิวหน้าของอุปกรณ์ไวแสงมากขึ้น ตัวอย่างวัสดุประสานรอยต่อ นำแสงได้แก่ กลีเซอร์รีน (Glycerine) มิเนอร์รอลออยล์ (Mineral oil) ซิลิโคนออยล์ (Silicone oil) และ สาร DC2000 เป็นต้น ซึ่งวัสดุประสานรอยต่อนำแสงจะเป็นของเหลวใสที่มีดัชนีหักเห ใกล้เกียงกับดัชนีหักเหของผลึก และมีความหนืด (Viscosity) อยู่ที่ 10⁶ เซนติสโตคส์ (Centistokes) ในกรณีที่ใช้เชื่อมต่อแบบถาวร และมีความหนืดที่ 3 x 10⁴ เซนติสโตคส์ สำหรับการเชื่อมต่อแบบ ชั่วคราว

3. การใช้วัสดุช่วยสะท้อนแสง (Refractor) เมื่อรังสีทำอันตรกิริยากับผลึกซินทิลเลชันจะ ทำให้เกิดประกายแสงกระจายออกจากผลึกในทุกทิศทาง แต่ในการใช้งานกับอุปกรณ์ไวแสง ส่วนมากแล้วจะมีเฉพาะผิวด้านใดด้านหนึ่งของผลึกที่สัมผัสกับส่วนไวแสง ดังนั้นจึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนประกายแสงในด้านอื่นๆ ให้กลับมาบริเวณผิวหน้าของวัสดุไวแสง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำเนิดสัญญาณ สำหรับวัสดุพื้นฐานที่ใช้ในการสะท้อนประกายแสงย่านความยาว กลื่น 300 – 500 nm ได้แก่ อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil) ส่วนประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ของวัสดุอื่นๆ แสดงในรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 แสดงประสิทธิภาพของวัสดุสะท้อนแสงชนิดต่างๆ [11]

จากผลของการสูญเสียปริมาณแสงคังกล่าวข้างค้น การประกอบผลึกเรื่องรังสีและพินโฟโต ใคโอคเพื่อใช้เป็นหัววัครังสีชนิคซินทิลเลชันจะต้องประกอบค้วยส่วนต่างๆ คังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 การประกอบผลึกวัครังสีกับพิน โฟโตไคโอค [9]

บทที่ 3

การพัฒนากระบวนการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม)

งานวิจัยนี้มีประสงค์เพื่อปลูกผลึกวัดรังสีซินทิลเลชันชนิด CsI(TI) สำหรับประกอบกับ พินโฟโตไดโอด ดังนั้นงานวิจัยจึงเริ่มจากการศึกษาและออกแบบระบบปลูกผลึกอย่างง่ายแบบ บริดจ์แมน-สตีอกบาร์เกอร์ พร้อมทั้งการเตรียมสารเริ่มต้นในการปลูกผลึก CsI(TI) จากนั้นจึงนำ ผลึกวัดรังสีที่ปลูกขึ้นได้มาศึกษาคุณสมบัติก่อนประกอบกับพินโฟโตไดโอด เพื่อทดสอบ ความสามารถในการวัดรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

3.1 ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบปลูกผลึก

ซีเซียมไอโอไดด์เป็นสารประกอบในกลุ่มอัลกาไลน์-เฮไลด์ (Alkaline halide) มีจุด หลอมเหลว 621°C สามารถระเหยสู่บรรยากาศได้ง่าย ขณะที่ทัลเลียมที่ใช้เป็นสารเจือจะอยู่ในรูป สารประกอบทัลเลียมไอโอไดด์ ซึ่งมีจุดหลอมละลาย 440°C มีความเป็นพิษต่อร่างกาย (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) จากข้อมูลดังกล่าวทำให้จำเป็นต้องออกแบบท่อปลูกผลึกเป็นระบบ ปิด โดยกระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกเลือกใช้เทคนิคการปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ จากสารหลอมเหลวภายใต้ความดันบรรยากาศของก๊าซอาร์กอน ซึ่งไม่เกิดปฏิกิริยา เกมีกับ CsI และ TII ระบบปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้นออกแบบให้ใช้อุปกรณ์พื้นฐาน และให้สมรรถนะ เพียงพอในการปลูกผลึกของสารดังกล่าว มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

 ชุดเตาหลอม 2 โซน และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ PID สามารถควบคุมอุณหภูมิของ ชุดเตาหลอมอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำได้อิสระจากกัน ออกแบบให้สามารถทำอุณหภูมิสูงสุดได้ 1000°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิเหนือจุดหลอมเหลวของ CsI (621°C) และ TII (440°C) ตามข้อมูลใน ภาคผนวก ข.

 ระบบบันทึกข้อมูลและสร้างเส้นกราฟอุณหภูมิด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ พัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้ในการทดสอบอัตราการเพิ่มอุณหภูมิของเตาหลอม และการปรับแกรเดียนท์ของอุณหภูมิภายใน ท่อปลูกผลึก ขณะสารเริ่มต้น (Charge sample) เคลื่อนที่ในโซนปลูกผลึก

ท่อปลูกผลิ์ก (Growth tube) รูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 มิลลิเมตร ยาว 1200 มิลลิเมตร เป็นแบบปลายปิดด้านล่าง และฝาด้านบนออกแบบให้เปิดปิด
 สำหรับใส่สารเริ่มต้น และมีท่อสำหรับสูบสุญญากาศพร้อมอัดก๊าซอาร์กอน

 ระบบสูบสุญญากาศและระบบควบคุมความดันก๊าซอาร์กอน สำหรับสูบอากาศออก หลังบรรจุสารเริ่มต้นในภาชนะปลูกผลึกและอัดก๊าซอาร์กอน ก่อนหลอมผงสารเริ่มต้นตาม กระบวนการปลูกผลึก

 ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก เลือกใช้ระบบเฟืองทครอบ ขับเคลื่อนด้วยสเต็ปเปอร์ (Stepper) สามารถปรับอัตราเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึกได้จาก 0.1 – 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

ภาชนะปลูกผลึก (Crucible) รูปทรงกระบอกปลายแหลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 10 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร

ส่วนประกอบทั้งหมดประกอบกันเป็นระบบเตาปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ แบบประหยัด ดังแผนภาพการสร้างในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แผนภาพโครงสร้างของเตาปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ ที่พัฒนาขึ้น

3.2 การพัฒนาเตาปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์

จากรายละเอียดองค์ประกอบในโครงสร้างเตาปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สตีอกบาร์เกอร์ สามารถออกแบบสร้างส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

3.2.1 ชุดเตาหลอมแบบ 2 โซน

โครงสร้างเตาหลอมออกแบบโซนความร้อนให้เป็นรูปทรงกระบอก เตาหลอมอุณหภูมิสูง มีโซนความร้อนยาว 15 มิลลิเมตร และเตาหลอมอุณหภูมิต่ำมีโซนความร้อนยาว 22 มิลลิเมตร เลือกใช้งคลวคความร้อนชนิด Kanthal-AF ขนาด 1.3 มิลลิเมตร ซึ่งทนอุณหภูมิสูงสุดได้ลึง 1400°C (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก.) เนื่องจากการปลูกผลึกนั้นเตาจะต้องทำงานหนักได้ อย่างต่อเนื่อง กำลังไฟฟ้าของเตาหลอมออกแบบไว้ที่ 1.2 kW ซึ่งสามารถคำนวณความยาวของขด ลวดความร้อนแล้วพันเป็นรูปคอยล์ (Helix) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เพื่อบรรจุ ลวดความร้อนแล้วพันเป็นรูปกอยล์ (Helix) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เพื่อบรรจุ ลวดความร้อนในร่องบรรจุขดลวดความร้อนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ดังใน รูปที่ 3.2 การปรับระยะห่างของขดลวดความร้อนมีผลต่อการจัดแกรเดียนท์ของอุณหภูมิบริเวณ โซนปลูกผลึก ดังนั้น ขดลวดความร้อนชุดบน (Primary heater) ซึ่งเป็นชุดที่ต้องตั้งอุณหภูมิสูงกว่า จุดหลอมเหลวของสารปลูกผลึกอย่างน้อย 20°C [2] จะพันให้มีความถิ่สูงกว่าขดลวดความร้อน ชุดล่าง (Secondary heater) ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของสารตามกวาม เหมาะสมของการจัดแกรเดียนท์ของอุณหภูมิที่ด้องการ



รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะของร่องบรรจุขดลวดความร้อนทรงกระบอกที่บรรจุขดลวดความร้อน

ชุดเตาหลอมจะต้องออกแบบให้มีความเสถียรของอุณหภูมิ ดังนั้นจึงต้องจัดฉนวนป้องกัน การสูญเสียความร้อน และการรบกวนของอุณหภูมิแวคล้อมจากภายนอกต่อบริเวณโซนปลูกผลึก ชุดฉนวนกันความร้อนเลือกใช้อิฐเบาทนไฟเนื้ออ่อน มีพื้นที่หน้าตัด 11.5 x 23 ตารางเซนติเมตร หนา 7.5 เซนติเมตร (รายละเอียดในภาคผนวก ง.) นำมาตัดแต่งรูปเป็นส่วนประกอบของระบบ เตาปลูกผลึกซึ่งมี 3 ส่วน ได้แก่

ก. ฉนวนที่ใช้ก่อเป็นตัวเตาหลอม จะหุ้มร่องบรรจุงคลวคความร้อนทรงกระบอก โดยเตา
 หลอมชุคบนหรือชุคอุณหภูมิสูงมีขนาดพื้นที่หน้าตัด 23 x 23 ตารางเซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร
 เตาหลอมส่วนล่างมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากันแต่สูง 22 เซนติเมตร

ง. ฉนวนที่ทำหน้าที่กันความร้อนโดยรอบชั้นนอกงองเตาหลอมทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ
 ช่วยรักษาให้อุณหภูมิที่ผิวด้านนอกงองเตาไม่สูงเกินไป และเกิดการสูญเสียความร้อนน้อย การ
 สูญเสียความร้อนมากเกินไป นอกจากจะทำให้เกิดการไม่คงตัวงองแกรเดียนท์งองอุณหภูมิแล้วยัง
 ทำให้สิ้นเปลียงพลังงานในการปลูกผลึกด้วย ในระบบเตาปลูกผลึกจะเพิ่มฉนวนโดยรอบงองเตา
 ปลูกผลึกด้านละ 5 เซนติเมตร ทำให้อุณหภูมิที่ผิวเตางณะทำงานมีอุณหภูมิสูงสุดเพียง 95°C

ค. แบฟเฟิล (Baffle) เป็นช่วงรอยต่อของโซนสำหรับปลูกผลึก เส้นผ่านศูนย์กลางของ
 แบฟเฟิลจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเตาปลูกผลึกและใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลาง
 ของท่อปลูกผลึก เนื่องจากต้องการให้เป็นส่วนป้องกันการรบกวนของอุณหภูมิของเตาทั้งสองโซน
 จากการเคลื่อนที่ผ่านของอากาศในบรรยากาศเกิดการพาความร้อนขึ้นระหว่างโซน



ก. อิฐทนไฟสำหรับเตาความร้อนและฉนวน

ข. แบฟเฟิล



ค. ฉนวนกันความร้อน

รูปที่ 3.3 แสดงส่วนประกอบของชุดเตาหลอม

3.2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิเตาหลอมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สตีอกบาร์เกอร์ เพราะด้องควบคุมอุณหภูมิของระบบให้คงที่มากที่สุด ในระบบเตาปลูกผลึกมีสอง โซนจะควบคุมอุณหภูมิอิสระจากกัน ดังนั้นจึงต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิสองชุดซึ่งมี ส่วนประกอบที่เหมือนกันคือ ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature sensors) ระบบควบคุมอุณหภูมิ แบบพีไอดี (PID temperature controller) และ โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay) จัดวงจรดัง แผนภาพรูปที่ 3.4

 ก. เตาอุณหภูมิต่ำ จะเลือกตัวตรวจวัดอุณหภูมิของระบบปลูกผลึกด้วยเทอร์โมคัปเปิล ชนิด K เนื่องจากสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดถึง 1200°C ติดตั้งไว้กึ่งกลางของเตาเพื่อวัดอุณหภูมิที่ผิว ด้านใน แล้วส่งสัญญาณเอาท์พุตไปยังระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีของบริษัท FENWAL รุ่น AR24L (ข้อมูลเทคนิคในภาคผนวก จ.) ซึ่งจะเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิกับค่าที่ต้องการ (Set point) แล้วส่งสัญญาณควบคุมการเปิดปิดวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโซลิดสเตทรีเลย์ของบริษัท ECHOWELL รุ่น P2425DL ซึ่งสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ถึง 6 kW ง. เตาอุณหภูมิสูงมีระบบควบคุมอุณหภูมิเช่นเดียวกับเตาอุณหภูมิต่ำ ต่างกันเพียงใช้ตัว กวบคุมอุณหภูมิแบบพี่ไอดีของบริษัท SIGMA รุ่น SF49 (ข้อมูลเทคนิคในภาคผนวก จ.) ซึ่งมี ฟังก์ชันสำหรับควบคุมอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Ramp rate) ตั้งแต่ 0.1 – 200°C ต่อนาที ทั้งนี้ เพราะเตาอุณหภูมิสูงมีอุณหภูมิสูงมาก (ประมาณ 750 - 900°C) จึงต้องควบคุมให้เพิ่มอุณหภูมิจาก อุณหภูมิห้องอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันการเสียหายจากจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (Temperature shock) และควบคุมให้สารที่ใช้ปลูกผลึกไม่เกิดการหลอมละลายเร็วเกินไป นอกจากนี้ยังใช้ควบคุมอัตราการลดอุณหภูมิของผลึก (Cool down) ในขั้นตอนสุดท้ายของ กระบวนการปลูกผลึก







รูปที่ 3.5 แสดงโครงสร้างของเตาปลูกผลึก

3.2.3 ระบบบันทึกข้อมูลและเส้นกราฟอุณหภูมิ

ในการทดลองเพื่อหาเงื่อนไขของการปลูกผลึก จำเป็นต้องทดสอบอัตราการตอบสนอง อุณหภูมิขณะเพิ่มและลด หรือการจัดแกรเดียนท์ของอุณหภูมิให้เหมาะสมกับกระบวนการปลูกผลึก จึงได้ออกแบบระบบบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ โดยใช้เครื่องดิจิตัลเทอร์ โมมิเตอร์อ่านก่าอุณหภูมิจาก บริเวณ โซนปลูกผลึกและส่งข้อมูลอุณหภูมิเชิงตัวเลขผ่านทางพอร์ตขนาน (Parallel port) ของ ใมโครคอมพิวเตอร์ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมอ่านข้อมูลด้วยภาษา C โดยจะอ่านข้อมูลทุก 1 นาที ขณะทดลองปลูกผลึกแล้วบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลระหว่างเวลากับอุณหภูมิ และอ่านข้อมูลทุกระยะ การเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึก 2.5 มิลลิเมตร (หลังจากหยุดรอ 5 นาที เพื่อให้อุณหภูมิกงที่) ขณะ ทดลองหาแกรเดียนท์ของอุณหภูมิแล้วบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลระหว่างระยะทางกับอุณหภูมิ โดยมี แผนผัง (Flow chart) การทำงานของโปรแกรมบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แผนผังการอ่านค่าอุณหภูมิ

3.2.4 ท่อปลูกผลึก

ท่อปลูกผลึกทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 304 (Stainless steel 304) ทรงกระบอกกลวง เส้นผ่าน สูนย์กลางภายใน 38 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ยาว 1200 มิลลิเมตร ส่วนล่างเชื่อมปิดสนิทแล้ว เจาะรูสำหรับสอดเทอร์โมคัปเปิลเข้าไปด้านในเพื่อวัดอุณหภูมิภายในบริเวณโซนปลูกผลึก ส่วน ด้านบนเชื่อมกับท่อทรงกระบอกเส้นผ่านสูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร สำหรับท่อทรงกระบอกที่นำมาเชื่อมต่อส่วนบนนี้ ด้านหนึ่งจะกลึงให้มีเส้นผ่านสูนย์กลางภายใน 40 มิลลิเมตร เพื่อเชื่อมต่อกับท่อปลูกผลึก อีกด้านหนึ่งจะกลึงเป็นเกลียวภายในเพื่อใช้เปิดปิดนำ ภาชนะปลูกผลึกเข้าออกท่อปลูกผลึก ในขณะเดียวกันบริเวณด้านข้างเจาะรูขนาด 1/4 นิ้ว จำนวน 2 รู เพื่อเชื่อมต่อกับข้อต่อทองเหลืองสำหรับระบบสุญญากาศและควบคุมความดันก๊าซ ส่วนอีกทาง หนึ่งใช้สำหรับติดตั้งวาวล์สำหรับปล่อยก๊าซส่วนเกินออก (Release valve) ดังโครงสร้างในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 แสดงลักษณะของท่อปลูกผลึก

3.2.5 ระบบสุญญากาศและควบคุมความคันก๊าซในท่อ

การปลูกผลึกจำเป็นต้องกำจัดสารอื่นๆ ที่อาจจะเกิดปฏิกิริยาใดๆ กับผลึกออกจากระบบ ดังนั้นต้องออกแบบระบบสุญญากาศเพื่อดูดอากาศออกจากท่อปลูกผลึก จากนั้นก็เติมก๊าซเฉื่อย (Inert gas) เข้าสู่ท่อปลูกผลึกซึ่งแขวนภาชนะปลูกผลึก ในระบบมีวาวล์ทำหน้าที่เปิด-ปิดสับเปลี่ยน การใช้งานระหว่างระบบสุญญากาศกับระบบควบคุมความดันก๊าซในท่อ ระบบสูบสุญญากาศใช้ เครื่องสูบแบบโรตารี (Rotary pump) เมื่อสูบอากาศภายในท่อปลูกผลึกจนถึงระดับที่ต้องการแล้วจะ เปลี่ยนระบบวาล์วไปใช้งานเป็นระบบควบคุมความดันก๊าซ ซึ่งใช้ก๊าซอาร์กอนความบริสุทธิ์ 99.999% ควบคุมความคันผ่านอุปกรณ์ควบคุมความคันก๊าซ (Pressure regulator) แล้วอ่านมาตรวัด ความคันภายในท่อปลูกผลึก

3.2.6 ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก

ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึกเลือกใช้ระบบเฟืองทด ออกแบบให้ระบบขับเคลื่อนท่อ ปลูกผลึกที่ใช้ในการปลูกผลึก สามารถปรับระดับอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึกได้จาก 0.1 – 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยสเต็ปเปอร์ (Stepper) และวงจรขับสเต็ปเปอร์ที่พัฒนาขึ้น ชุดเฟืองทดรอบซึ่งสามารถทดรอบได้ถึง 1/750 ประกอบอยู่กับเฟืองเกลียวหนอนที่มีระยะฟัน (Pitch) 1 มิลลิเมตร ทำหน้าที่รองรับการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึก ในขณะที่ต้องการเคลื่อนท่อ ปลูกผลึกให้เข้าตำแหน่งของโซนเริ่มต้น ได้จัดระบบเฟืองทดให้มีอัตราการทดรอบเพียงแก่ 3/4 ใช้สเต็ปเปอร์เช่นเดียวกัน สามารถปรับอัตราการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึกได้สูงสุดถึง 5 เซนติเมตร ต่อนาที ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึกทั้งสองสัดส่วนแสดงในรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แสดงระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก

3.2.7 ภาชนะปลูกผลึก

ภาชนะปลูกผลึกต้องทนความร้อนได้สูง ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ กับสารที่ปลูกผลึก และมี สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนน้อยกว่าผลึก เนื่องจากขณะลดอุณหภูมิของผลึกจะทำให้เกิด การหดตัวของผลึกและภาชนะปลูกผลึก โดยผลึกควรจะหดตัวได้มากกว่าภาชนะปลูกผลึกเพื่อให้ นำผลึกออกจากภาชนะปลูกผลึกได้ง่าย ทั้งนี้หากภาชนะปลูกผลึกสามารถหดตัวได้มากกว่าอาจทำ ให้ทั้งภาชนะปลูกผลึกหรือผลึกแตกออกจากกันในขณะลดอุหณภูมิของผลึก ดังนั้นจึงใช้แก้ว ไวคอร์เป็นภาชนะปลูกผลึก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร จากด้านบนลงมา 20 มิลลิเมตร ทำรอยบากสองจุดเพื่อใช้แขวนภาชนะปลูกผลึกไว้ กับโซ่ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ออกแบบและสร้างขึ้นนำมาประกอบเป็นโครงยึด ซึ่งมีขนาด 34 ซม. x 34 ซม. x 200 ซม. ส่วนขาทั้งสี่ของโครงสร้างจะมีสกรูสำหรับปรับระดับเตาปลูกผลึกให้ตั้งตรงใน แนวดิ่ง ซึ่งจะวางอยู่บนแผ่นเหล็กที่วางอยู่บนแผ่นยางอีกชั้นหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ลดการสั่นสะเทือนที่ เกิดจากพื้นที่ติดตั้ง ระบบปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้นแสดงในภาพถ่ายรูปที่ 3.9



- 1. เตาปลูกผลึก
- ระบบขับเคลื่อนท่อปลูกผลึก
 ระบบบันทึกข้อมูลและ
- . ระบบบนทางอมูถและ เส้นกราฟอุณหภูมิ
- ระบบสุญญากาศและควบคุม ความดันก๊าซในท่อปลูผลึก
 ท่อปลูกผลึก

รูปที่ 3.9 เตาปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้น

3.3 การออกแบบอุปกรณ์ทดสอบการตอบสนองการวัดรังสีของผลึก CsI(Tl)

ผลึกวัดรังสีที่ปลูกได้จากงานวิจัยจะต้องนำมาทคสอบความสามารถในการวัดพลังงานรังสี เอกซ์และรังสีแกมมา ดังนั้นจึงต้องออกแบบอุปกรณ์ทคลองและระบบวัดรังสีที่สามารถวิเคราะห์ พลังงานของรังสีได้ โดยเลือกอุปกรณ์ขยายสัญญาณส่วนหน้าให้เหมาะกับอุปกรณ์ไวแสงที่ใช้ใน การทคลอง

3.3.1 การประกอบอุปกรณ์ทคลองผลึกวัครังสี

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกอุปกรณ์ไวแสง 2 ชนิด ในการทดสอบความสามารถในการวัดรังสี ของผลึก CsI(TI) ได้แก่ หลอดไวแสงชนิดทวีคูณอิเล็กตรอน (PMT) ของ RCA รุ่น 5819 ซึ่งรับแสง ด้านหน้า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และฟินโฟโตไดโอดของ Hamamatsu เบอร์ S3590-8 (รายละเอียดเทกนิกในภาคผนวก ฉ.) มีพื้นที่รับแสง 100 ตารางมิลลิเมตร การประกอบอุปกรณ์ ไวแสงเข้ากับผลึกวัดรังสีจะต้องระมัดระวังเรื่องแสงรบกวนจากภายนอก สิ่งรบกวนทาง อิเล็กทรอนิกส์ และการประสานผลึกกับผิวรับแสงของอุปกรณ์ไวแสง ดังนั้นโครงสร้างของ อุปกรณ์ทดลองทั้ง 2 แบบ จึงมีโครงสร้างดังในรูปที่ 3.10 และ 3.11



รูปที่ 3.11 แสดงการประกอบ P-I-N Photodiode กับผลึก CsI(Tl)

3.3.2 ระบบวิเคราะห์พลังงานของรังสี

การจัดระบบวิเคราะห์พลังงานของรังสีแสดงในรูปที่ 3.12 ประกอบด้วย อุปกรณ์ขยาย สัญญาณพัลส์ที่สามารถเลือกค่า shaping time ใด้ อุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (MCA) แหล่งง่ายไฟฟ้าแรงดันสูง สำหรับไบอัสหัววัดรังสี สำหรับอุปกรณ์ขยายส่วนหน้าของการทดลอง ใช้ PMT กับผลึกวัดรังสี เลือกใช้อุปกรณ์ขยายไวต่อแรงดันไฟฟ้า (Voltage sensitive) จัดวงจรแบบ pulse type ส่วนอุปกรณ์ขยายส่วนหน้าของการทดลองใช้ P-I-N photodiode กับผลึกวัดรังสี เลือกใช้ อุปกรณ์ขยายไวต่อประจุ (Charge sensitive) จัดวงจรแบบ pulse type เช่นกัน



บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

งั้นตอนการพัฒนากระบวนการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) อย่างง่าย ประกอบด้วย การพัฒนาระบบปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สตีอกบาร์เกอร์ ที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หา ได้ง่าย และการทดลองปลูกผลึกของซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) จากสารเริ่มต้นของผง CsI ความ บริสุทธิ์ 99.9% และสารเจือทัลเลียมในรูปผง TII ความบริสุทธิ์ 99.999% ด้วยเงื่อนไขของการ ปลูกผลึกและอัตราส่วนของสารเจือต่างๆ เพื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติของผลึกใน 2 กรณี ได้แก่ การทดสอบคุณสมบัติกวามเป็นผลึกเดี่ยวและปริมาณสารเจือทัลเลียมในผลึก รวมทั้งการนำผลึก ไปประกอบกับพินโฟโตไดโอด เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นหัววัดซินทิลเลชันและทดสอบคุณสมบัติใน การแจกแจงพลังงานในการวัดรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

4.1 การทดสอบคุณลักษณะของเตาปลูกผลึก

การทดสอบคุณลักษณะของเตาปลูกผลึกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบ ผลตอบสนองการเพิ่มอุณหภูมิก่อนเข้าสู่สภาวะเสถียร (Temperature response) และแกรเดียนท์ของ อุณหภูมิบริเวณโซนปลูกผลึก เมื่อตั้งอุณหภูมิของเตาหลอมชุดอุณหภูมิสูงและชุดอุณหภูมิต่ำที่ ระดับอุณหภูมิต่างๆ โดยแบ่งตำแหน่งการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ บริเวณโซนปลูกผลึก ดังในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงตำแหน่งของการอ่านอุณหภูมิบริเวณโซนปลูกผลึก

4.1.1 การทดสอบผลตอบสนองการเข้าสู่สภาวะเสถียรของอุณหภูมิ

เริ่มด้วยการติดตั้งเทอร์ โมกัปเปิลภายในท่อปลูกผลึก และสูบอากาศออกจากท่อปลูกผลึก จากนั้นอัดก๊าซอาร์กอนสู่ท่อปลูกผลึกที่ความดัน 2 บรรยากาศ จัดตำแหน่งของท่อปลูกผลึกให้ ตำแหน่งของปลายเทอร์ โมกัปเปิลอยู่บริเวณเริ่มต้นของการปลูกผลึกและเริ่มให้ความร้อนกับระบบ พร้อมบันทึกก่าอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที ผลการทคลองเป็นไปตามเส้นกราฟรูปที่ 4.2 โดยอัตราการ เพิ่มของอุณหภูมิขึ้นกับการควบคุมของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาโซนบน จากผลการทคลอง พบว่า อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่เข้าสู่สภาวะเสลียรเร็วที่สุดในเวลา 7 ชั่วโมง



รูปที่ 4.2 เส้นกราฟแสดงผลตอบสนองการเข้าสู่สภาวะเสถียรของอุณหภูมิเตาปลูกผลึก

4.1.2 การทดสอบแกรเดียนท์ของอุณหภูมิ (Temperature gradient)

การปรับแกรเดียนท์ของอุณหภูมิให้เหมาะสมกับกระบวนการปลูกผลึก เป็นการปรับ โปรไฟล์ของอุณหภูมิ (Temperature profile) บริเวณ โซนปลูกผลึกของเตาปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้น แกรเดียนท์ของอุณหภูมิเกิดจากการตั้งค่าความแตกต่างของอุณหภูมิของเตาหลอมชุดอุณหภูมิสูง และเตาหลอมชุดอุณหภูมิต่ำ และเคลื่อนท่อปลูกผลึกให้เทอร์ โมคัปเปิลวัดค่าอุณหภูมิตลอด โซน ปลูกผลึกคังในรูปที่ 4.1 จากด้านบน (อุณหภูมิสูง) สู่ด้านล่าง (อุณหภูมิต่ำ) เพื่อหาตำแหน่งของจุด หลอมเหลวของสารปลูกผลึกบริเวณกึ่งกลางของแบบเฟิล ในการทดลองนี้จัดให้ระบบอ่านค่า อุณหภูมิด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึกพร้อมอ่านค่าอุณหภูมิ หลังจากหยุดการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึกเป็นเวลา 5 นาที ทุกระยะทาง 2.5 มิลลิเมตร ผลทดลอง ปรับค่าความแตกต่างของอุณหภูมิและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแบฟเฟิล 55 และ 70 มิลลิเมตร หนา 80 มิลลิเมตร พบว่าแบฟเฟิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มิลลิเมตร จะให้ความเสถียรของ อุณหภูมิคีกว่าและให้เส้นกราฟแกรเคียนท์ของอุณหภูมิคังรูปที่ 4.3 พร้อมตารางที่ 4.1 สรุปเงื่อนไข แกรเคียนท์ของอุณหภูมิ



รูปที่ 4.3 เส้นกราฟคุณลักษณะแกรเคียนท์อุณหภูมิของเตาปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้น เมื่อใช้แบฟเฟิลขนาคเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มิลลิเมตร

-	લ વા	ସ
แกรเคียนท์ของอุณหภูมิ	อุณหภูมิของเตาอุณหภูมิสูง	อุณหภูมิของเตาอุณหภูมิต่ำ
(^o C/cm)	°C)	(°C)
11.00	725	550
21.72	767	455
31.16	820	355
37.48	845	285

ตารางที่ 4.1 แสดงแกรเดียนท์ของอุณหภูมิจากการทดลองใช้แบฟเฟิลเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม.

4.2 การทดลองปลูกผลึก

4.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง

- สารเคมี ได้แก่ CsI ชนิดผงความบริสุทธิ์ 99.9% และ TII ชนิดผงความบริสุทธิ์ 99.999%
- ภาชนะปลูกผลึกทำด้วยแก้วไวคอร์ (Vycore) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร มีขนาดมุมกันแก้วประมาณ 60°
- 3. เครื่องชั่งน้ำหนักละเอียด 0.0001 กรัม
- 4. ก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ์ 99.999%
- เตาปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้น
- 6. เครื่องทำความสะอาคชนิคอุลตราโซนิค (Ultrasonic cleaner)

4.2.2 การเตรียมสารปลูกผลึก

ได้ทดลองเตรียมสารปลูกผลึกเพื่อทดลองปลูกผลึก CsI และ CsI(TI) โดยคำนวณหา ปริมาณสารต่อปริมาตรหลังการหลอมและก่อผลึกในภาชนะบรรจุ พร้อมทั้งปริมาณของสารเจือ ทัลเลียมในเงื่อนไขต่างๆ ในการทดลองนี้ได้ทดลองเตรียมสัดส่วนของสารเพื่อบรรจุในภาชนะ ปลูกผลึกไวคอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และสูง 100 มิลลิเมตร หรือปริมาตรที่หวังผล ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อให้ได้ผลึกที่ปลูกขึ้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร หนา 30 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะของภาชนะบรรจุสารและรูปร่างผลึก

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ปริมาณสารเจือ Tl	น้ำหนักของผง CsI	น้ำหนักของผง Tll
<u> </u>	(% โคยโมล)	(ຄรັນ)	(ນີດຄືກรັນ)
C002	0.3619	9.87542	45.74
C003	0.1079	9.47416	13.05
C004	0.0599	11.24742	8.05
C005	0.1772	8.92457	20.20

ตารางที่ 4.2 ปริมาณของส่วนผสมของสารที่ใช้ในการปลูกผลึก

การบรรจุสารเริ่มต้นจะต้องทำความสะอาคภาชนะบรรจุด้วย Ultrasonic cleaner และผสม สารเริ่มต้นให้เข้ากัน บรรจุลงในภาชนะปลูกผลึกด้วยการสั่นให้เนื้อแน่นและปิดฝาด้วยแกรไฟท์ เพื่อกันการฟุ้งกระจายของสารทัลเลียมภายในท่อปลูกผลึก เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าซีเซียม ไอโอไดด์

## 4.2.3 การปลูกผลึกด้วยกระบวนการแบบบริดจ์แมนชนิดแนวตั้ง

สารที่เตรียมได้ในภาชนะบรรจุจะนำมาแขวนในท่อปลูกผลึกด้วยโซ่เหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ ้ลคการสั้นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ของท่อปลูกผลึก และทำการสูบอากาศออกจากท่อปลูกผลึก ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนอัดก๊าซอาร์กอนความบริสุทธิ์ 99.999% ความคัน 2 เท่าบรรยากาศ การปลูกผลึกเริ่มจากการปรับอุณหภูมิของเตาหลอมทั้ง 2 โซนให้ได้แกรเดียนท์ตามเงื่อนไขที่ ต้องการ ในการทคลองนี้เลือกใช้แกรเคียนท์ของอุณหภูมิที่ 37.48°C/cm พร้อมทั้งจัคตำแหน่ง ปลายภาชนะปลูกผลึกให้อยู่เหนือระดับตำแหน่งอุณหภูมิหลอมเหลวของสารซีเซียมไอโอไดด์ ประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวประมาณ 30°C ดังแสดง ในรูปที่ 4.5 เริ่มเดินระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโซนปลูกผลึกและรอให้ระบบเข้าสู่สภาวะเสถียร ้เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ก่อนเคลื่อนท่อปลูกผลึกด้วยอัตราเร็วต่างๆ ที่เลือกใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง หลังจากส่วนบนสุดของผลึกเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งจุดหลอมเหลวของซีเซียมไอโอไคด์ (621°C) เป็นระยะทางประมาณ 1 เซนติเมตร หรืออุณหภูมิบริเวณส่วนบนสุดของผลึกต่ำกว่าจุดหลอมเหลว ประมาณ 30°C แล้ว จะปรับเปลี่ยนอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของภาชนะปลูกผลึกเป็น 5 มิลลิเมตร ้ต่อชั่วโมง สำหรับกรณีของการปลูกผลึกด้วยอัตราเร็ว 1 และ 2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลด ระยะเวลาในการปลูกผลึก รอจนกระทั่งส่วนบนสุดของผลึกเกลื่อนที่ผ่านตำแหน่งจุดหลอมเหลว ของทัลเลียมไอโอไดด์ (440°C) ประมาณ 1 เซนติเมตร จึงลดอุณหภูมิของเตาส่วนบนจาก 845°C เป็น 450°C โดยควบคุมอัตราการถดอุณหภูมิเป็น 1 องศาต่อนาที (ควบคุมโดยฟังก์ชันของตัว ้ควบคุมอุณหภูมิของเตาส่วนบน) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที แล้วปีคระบบพลังงาน

ของเตาปลูกผลึกเพื่อให้เกิดการลดอุณหภูมิของระบบปลูกผลึกโดยธรรมชาติ รอจนกระทั่งเตา ปลูกผลึกมีอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้องแล้วจึงนำผลึกออกจากท่อปลูกผลึก



รูปที่ 4.5 การจัดตำแหน่งของภาชนะบรรจุสารในการปลูกผลึก

#### 4.2.4 ผลการปลูกผลึก

จากการทดลองปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ เพื่อทดสอบผลของผลึกเบื้องดัน โดยเลือก แกรเดียนท์ของอุณหภูมิ 37.48°C/cm ซึ่งก่อนข้างจะให้ความเป็นเชิงเส้นของเส้นกราฟสูง และ เปลี่ยนอัตราเร็วของท่อปลูกผลึกที่ 1, 2 และ 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พบว่าหากทำความสะอาด ภาชนะปลูกผลึกไม่สะอาดพอ ผลึกจะเกิดความขุ่นและมีเนื้อไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากสิ่งสกปรกจะ ปะปนกับการจัดเรียงตัวขณะก่อผลึกทำให้สูญเสียระเบียบโครงสร้าง หลังจากทำความสะอาด ภาชนะปลูกผลึกด้วยเครื่องอุลตราโซนิค ผลึกที่ปลูกได้จะมีลักษณะใส ขณะเดียวกันอัตราเร็วใน การเคลื่อนท่อปลูกผลึกที่ทดลองยังอยู่ในช่วงที่สามารถก่อผลึกได้ดี จึงไม่ให้ผลความแตกต่างของ ผลึก สิ่งที่พบในการทดลองเบื้องด้น คือ ขณะปลูกผลึกโดยปิดฝาภาชนะปลูกผลึกและเปิดฝานั้น จะ ให้ผลความแตกต่างที่ผิวหน้าส่วนบนของผลึก โดยขณะเปิดฝาจะมีการยุบตัวเป็นหลุมของผิวหน้า ลึกและผิวไม่เรียบ ดังนั้นในการปลูกผลึก CsI(TI) จึงเลือกใช้อุณหภูมิแกรเดียนท์ 37.48°C และอัตราเร็ว ในช่วง 1, 2 และ 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เพื่อศึกษาเงื่อนไขในการก่อผลึกและศึกษาปริมาณของ สารเงือทัลเลียม ผลการทดลองปลูกผลึก CsI(TI) จากการเตรียมสารเริ่มต้นตามตารางที่ 4.2 ให้ผล ของรูปลักษณ์ในการปลูกผลึกดังตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.6 ในแง่ของผลึกวัดรังสีความใสของผลึก จะช่วยให้การส่งประกายแสงทำได้ดี และไม่เกิดการดูดกลืนความเข้มของประกายแสง

	ŧJ - `				
	อัตราเร็วของ	ปริมาณของ		สีของผลึก	
รหัสผลิ์ก	ท่อปลู <mark>กผลึก</mark>	สารเจื้อ Tl	ลักษณะผลึก		
	(mm/h)	(% โด <mark>ยโมล)</mark>			
C002	5	0.3619	ใส	เหลืองอ่อน	
C003	1	0.1079	ใส	ใส	
C004	2	0.0599	ใส	ใส	
C005	1	0.1772	ใส	เหลืองอ่อน	

a			1 8	
mn~1990	1 2	ຢລາເລາລາຮາ	เลอยเลือ	$C_{-1}(T1)$
	4 1	WOMPINTIAL	ιατιωατι	USILID
		1,01,00,11,10,1		001(11)



รูปที่ 4.6 ตัวอย่างผลึกวัครังสี CsI(Tl) ที่ปลูกขึ้น

#### 4.3 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของผลึก

ผลึก CsI(TI) ที่ได้จากกระบวนการปลูกผลึก ได้นำไปทดสอบโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิก การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) เพื่อตรวจสอบความเป็นผลึกเดี่ยวและการวิเคราะห์หาปริมาณ ทัลเลียมที่เจือในผลึกซีเซียมไอโอไดด์ ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน (EDXRF) โดยตัดแบ่งผลึกออกเป็น 3 ส่วน ดังรูปที่ 4.7 เนื่องจากผลึกซีเซียมไอโอไดด์เป็นผลึกที่ อ่อนเปราะ (Soft and brittle) การเตรียมผลึกจึงใช้เลื่อยฉลุซึ่งมีขนาดเล็กตัดชิ้นงานได้ จากนั้นนำไป ขัดผิวผลึกให้เรียบและได้ระนาบ โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 1000 ขัดร่วมกับแอลกอฮอล์ และทำ การขัดอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 4000 ร่วมกับแอลกอฮอล์ ตามด้วยการขัดกับ ผ้ากำมะหยี่



รูปที่ 4.7 แสดงการตัดผลึกเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความเป็นผลึกเดี่ยว

จากการนำผลึก CsI(TI) รหัส C002, C003, C004 และ C005 ซึ่งปลูกผลึกด้วยแกรเดียนท์ ของอุณหภูมิ แต่แตกต่างกันที่การผสมปริมาณสารทัลเลียมก่อนปลูกผลึกและอัตราการเคลื่อนที่ของ ท่อปลูกผลึก แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังรูปที่ 4.7 และนำผลึกส่วนกลางไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วย เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) โดยใช้เครื่องวิเคราะห์รุ่น JDX-8030 ของบริษัท JEOL ผลการตรวจวิเคราะห์ผลึกส่วนกลางด้านบนและด้านล่าง พบว่าผลึกมีความเป็นระนาบผลึกชัดเจน และมีระนาบเดียวกันทั้งด้านบนและด้านล่าง ดังผลวิเคราะห์ในรูปที่ 4.8



ก. ผลวิเคราะห์ XRD ของผลึก CsI(Tl) รหัส C002

ข. ผลวิเคราะห์ XRD ของผลึก CsI(Tl) รหัส C004



ค. ผลวิเคราะห์ XRD ของผง CsI

รูปที่ 4.8 ผลการตรวจวิเคราะห์ผลึก CsI(TI) ที่ปลูกขึ้นด้วยเทคนิค XRD

4.3.2 ผลวิเคราะห์ปริมาณสารเจือทัลเลียมในผลึก

ใด้นำผลึกที่เตรียมได้หลังการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกแล้ว มาวิเคราะห์หาปริมาณทัลเลียม ด้วยเครื่องวิเคราะห์ EDXRF รุ่น ED2000 ของบริษัท Oxford โดยเลือกใช้โปรแกรมวิเคราะห์ชนิด Semi fundamental เนื่องจากตัวอย่างไม่มีปัญหาเรื่องผลของแมทริกซ์ (Matrix effect) ใช้เงื่อนไข วิเคราะห์ตามภาคผนวก ช. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างแสดงในตารางที่ 4.4

รหัสผลึก	Tl mol%	Tl mol% ในส่วนต่างๆ ของผลึก			
	ในผงสารเริ่มต้น	Тор	Middle	Bottom	
C002	0.3619	0	0.0430	0.0548	
C003	0.1079	0	0.0489	0.0490	
C004	0.0 <mark>5</mark> 99	0	0.0256	0.0255	
C005	0.1772	0	0.0806	0.0103	

ตารางที่ 4.4 ผลวิเคราะห์ปริมาณสารเจือทัลเลียมในผลึก CsI(Tl)

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารทัลเลียมพบว่าการกระจายตัวของทัลเลียมในแนวเกรเคียนท์ไม่ สม่ำเสมอและไม่เป็นรูปแบบที่แน่นอน

## 4.4 การวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงาน

ได้นำผลึกส่วนกลาง (Middle) มาทคสอบคุณภาพในการวิเคราะห์พลังงานของรังสีแกมมา โดยประกอบเข้ากับอุปกรณ์ไวแสง 2 ชนิด ได้แก่ หลอดไวแสงชนิดทวีปริมาณอิเล็กตรอน (PMT) และพิน โฟโตไดโอด (P-I-N Photodiode) เนื่องจากผลึก CsI(TI) มีความไวต่อความชื้นเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติผิวจะเริ่มงุ่น ก่อนประกอบเข้ากับอุปกรณ์ไวแสงจะต้องขัด ผิวหน้าออกให้ถึงส่วนของผลึกที่ใส แล้วใช้สารเชื่อมประสานผิวหน้า (Fluid coupling) เพื่อให้ หน้าสัมผัสผิวหน้าสนิทกับผิวหน้าของอุปกรณ์ไวแสง ลดการสูญเสียความเข้มประกายแสงที่จะ หักเหจากทิศทาง และจำเป็นต้องเคลือบฟอล์ยอลูมิเนียมที่ผิวส่วนที่เหลือเพื่อช่วยสะท้อนประกาย แสงเข้าสู่ผิวหน้าของอุปกรณ์ไวแสง

#### 4.4.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง

- 1. PMT (Photomultiplier Tube) VON RCA model 5819
- 2. P-I-N Photodiode ของ Hamamatsu เบอร์ S3590-8
- 3. High voltage power supply VON ORTEC model 478
- 4. Preamplifier with tube base VON ORTEC model 276
- 5. Preamplifier VON CANBERRA model 2006
- 6. Amplifier VON CANBERRA model 2022
- 7. Multichannel analyzer UOI Tracor Northern model TN-1760
- 8. NIM bin with power supply VON ORTEC model 4001C/4002A
- 9. ต้นกำเนิดรังสีแกมมา Cs-137 และ Am-241



รูปที่ 4.9 แผนภาพการจัคระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานรังสีแกมมา

4.4.2 ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานด้วยผลึก CsI(Tl) ประกอบกับ PMT

ตามปกติอุปกรณ์ไวแสง PMT จะเหมาะกับผลึกเรืองรังสี CsI(Na) [4] เนื่องจากย่านการ ปล่อยประกายแสงจะเหมาะกับบริเวณความไวสูงของการตอบสนองความไวแสงของ PMT ในการ ทดลองนี้ได้อาศัยบริเวณของย่านตอบสนองความไวแสงที่ต่ำกว่ามาศึกษาผลการปล่อยประกายแสง ของ CsI(TI) ซึ่งอยู่ในย่าน 320 – 750 nm ก่อนนำไปใช้กับโฟโตไดโอด ผลการทดลองใช้ผลึกวัด รังสีที่พัฒนาขึ้นที่ความแตกต่างของปริมาณทัลเลียมและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร หนา 8 มิลลิเมตร วัดพลังงานของรังสีแกมมา 662 keV ของ Cs-137 และผลึกขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร วัดพลังงาน 59.6 keV ของ Am-241 เปรียบเทียบกับผลึก NaI(TI) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร หนา 25.4 มิลลิเมตร ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยวัด

# ให้พิคพลังงานของรังสีสูงเท่ากันและอยู่ที่ตำแหน่งช่องวิเคราะห์พลังงานเดียวกัน ให้ผลการ วิเคราะห์พลังงานดังสเปกตรัมใน รูปที่ 4.10 และ 4.11 ตามลำดับ



รูปที่ 4.11 สเปกตรัมพลังงานของ Am-241 จากผลึกวัดรังสี CsI(Tl) ที่พัฒนาขึ้น

ผลของสเปกตรัมจากผลึกที่มีปริมาณทัลเลียม 0.0256 – 0.0806 mol% ในการวัดพลังงาน รังสีแกมมาของ Cs-137 โดยจัดระบบวัดดังรูปที่ 4.9 ด้วยการปรับตำแหน่งพีคของพลังงานอยู่ที่ ตำแหน่งเดี่ยวกันและใช้ shaping time ที่ 2 µs พบว่า ให้ความสามารถในการแจกแจงพลังงาน (Resolution) ระหว่าง 13.67 – 14.39% ซึ่งใกล้เคียงกับผลึกที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีความสามารถ ในการแจกแจงพลังงานที่ 12.98% และผลของสเปกตรัมของผลึกที่มีปริมาณทัลเลียม 0.0548 และ 0.0489 mol% ในการวัดพลังงานของ Am-241 พบว่าให้ความสามารถในการแจกแจงพลังงานที่ 34.18% และ 37.03% ตามลำดับ ทั้งนี้ความสามารถในการแจกแจงพลังงานที่ 34.18% และ 37.03% ตามลำดับ ทั้งนี้ความสามารถในการแจกแจงพลังงานของผลึกที่พัฒนาขึ้นจะ สูงกว่าผลึกที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เล็กน้อย โดยผลึกในเชิงพาณิชย์ให้ความสามารถในการแจกแจง พลังงานที่ 31.21% ผลึก CsI(TI) ที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีสารเจือทัลเลียมระหว่าง 0.0256 – 0.0806 mol% ให้ขนาดพัลส์ใกล้เคียงกัน เนื่องจากความสว่างประกายแสงใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดกล้องกับ ผลการวิจัยของ Harshaw [4] ซึ่งได้กล่าวว่า ผลึก CsI ที่เจือสารทัลเลียมระหว่าง 0.04 – 0.1 mol% จะ ให้ประสิทธิภาพของการเกิดประกายแสงมากกว่า 90%

## 4.4.3 ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานด้วยผลึก CsI(TI) ประกอบกับพินโฟโตไดโอด

จากการนำผลึกชุดเดียวกับการทดลองในข้อ 4.4.2 มาประกอบกับพินโฟโตไดโอด เพื่อวัด พลังงานของรังสีแกมมา 662 keV ของ Cs-137 ใช้ภาคขยายส่วนหน้าของบริษัท CANBERRA model 2006 วัดให้พีคของรังสีสูงเท่ากันและอยู่ที่ตำแหน่งช่องวิเคราะห์พลังงานเดียวกัน ให้ผลของ สเปกตรัมพลังงานดังในรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 สเปกตรัมพลังงานของ Cs-137 จากผลึก CsI(TI) กับพินโฟโตไดโอค

ผลของสเปกตรัมพลังงาน 662 keV ของ Cs-137 ที่วิเคราะห์ได้จากระบบวัดในรูปที่ 4.9 พบว่าความสามารถในการแจกแจงพลังงานของผลึก CsI(TI) ที่ใช้งานร่วมกับพินโฟโตไดโอดให้ ความสามารถในการแจกแจงพลังงานที่ด้อยกว่าผลึก NaI(TI) ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ใช้งามร่วมกับ PMT โดยให้ความสามารถในการแจกแจงพลังงานที่ 15.48% ที่ปริมาณทัลเลียม 0.0806 mol% ในขณะที่ผลึกที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ให้ความสามารถในการแจกแจงพลังงานที่ 12.98%

## 4.4.4 ประสิทธิภาพการแปล่งประกายแสงของผลึก

ผลการนำผลึก CsI(TI) ที่มีปริมาณทัลเลียมระหว่าง 0.0256 – 0.0806 mol% ขนาดเส้นผ่าน สูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร หนา 8 มิลลิเมตร ประกอบกับหลอดไวแสงชนิดทวีคูณอิเล็กตรอน (PMT) และวิเคราะห์พลังงานของรังสีแกมมาจาก Cs-137 ที่อัตราขยายสัญญาณคงที่ เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการเปล่งประกายแสงจากผลของขนาดสัญญาณพัลส์ ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของพีค (Peak centroid) พบว่าผลึกที่มีปริมาณสารเจือทัลเลียมสูงขึ้นมีแนวโน้มจะให้ประสิทธิภาพในการ เปล่งประกายแสงมากขึ้น แต่หากปริมาณสารเจือทัลเลียมมีมากเกินไปก็จะทำให้ประสิทธิภาพใน การเปล่งประกายแสงลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีพารามิเตอร์อื่นๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องได้ เช่น ระนาบของผลึก ความใส และ ความบกพร่องของผลึก



รูปที่ 4.13 เปรียบเทียบตำแหน่งพีคพลังงานของ Cs-137 จากการวิเคราะห์พลังงาน ด้วยผลึก CsI(TI) ที่มีสารเจือทัลเลียมต่างกัน

## บทที่ 5

## สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย

## 5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการพัฒนากระบวนการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไคด์ (ทัลเลียม) อย่างง่าย ได้แบ่งงานวิจัย ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาระบบปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ ซึ่งใช้วัสดุและ อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายพร้อมกระบวนการปลูกผลึก อีกส่วนหนึ่งคือการศึกษาผลของผลึกที่ปลูกได้ ทั้งคุณสมบัติพื้นฐานและผลการตอบสนองการวัดรังสีแกมมา ซึ่งผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้

5.1.1 เตาปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้นสามารถปรับแกรเดียนท์ของอุณหภูมิได้ด้วยการปรับความ แตกต่างอุณหภูมิของเตาหลอมชุดอุณหภูมิสูงและต่ำ ประกอบกับการจัดขนาดความหนาของ แบฟเฟิล รวมทั้งการจัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแบฟเฟิลให้พอดีกับขนาดของท่อปลูกผลึก จะช่วยลดผลการรบกวนของการพาความร้อน (Convection flow) บริเวณช่องว่างระหว่างท่อ ปลูกผลึกกับแบฟเฟิล ทำให้บริเวณโซนปลูกผลึกมีความเสถียรของอุณหภูมิสูง โดยการเข้าสู่ภาวะ อุณหภูมิเสถียรของเตาใช้เวลา 7 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังออกแบบให้ปรับอัตราการเคลื่อนที่ของท่อ ปลูกผลึกได้จาก 0.1 – 5 mm/hr

5.1.2 ผลการปลูกผลึก CsI(TI) โดยใช้สารเริ่มต้นเป็นผง CsI ความบริสุทธิ์ 99.9% ผสม กับผง TII ความบริสุทธิ์ 99.999% บรรจุในภาชนะปลูกผลึกที่ทำด้วยไวคอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน 10 mm แขวนในท่อปลูกผลึกที่ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมแบบปิด อัดก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ์ 99.999% ความดัน 2 บรรยากาศ ที่แกรเดียนท์ของอุณหภูมิ 38.47°C/cm และอัตราการเคลื่อนที่ ของผลึก 1, 2 และ 5 mm/hr พบว่าผลึกที่ได้เป็นผลึกเดี่ยวมีความใส สามารถควบคุมปริมาณ สารเจือทัลเลียมในผลึก CsI ได้ในช่วง 0.0256 – 0.0806 mol%

5.1.3 ผลการใช้ผลึก CsI(TI) เป็นผลึกวัดรังสีประกอบกับพินโฟโตไดโอดของบริษัท Hamamatsu รุ่น S3590-8 ในการวิเกราะห์สเปกตรัมพลังงานรังสีแกมมา พบว่าผลึก CsI(TI) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร กวามหนา 8 มิลลิเมตร ให้กวามสามารถในการแจกแจงพลังงาน 15.48% ที่พลังงาน 662 keV นอกจากนี้ยังทดลองใช้ผลึกที่กวามหนา 8 และ 4 มิลลิเมตร ประกอบ กับหลอดไวแสงชนิดทวีกูณอิเล็กตรอนของบริษัท RCA รุ่น 5819 วัดสเปกตรัมพลังงานของรังสี แกมมา พบว่าให้กวามสามารถในการแจกแจงพลังงาน 13.67% ที่พลังงาน 662 keV และ 34.18% ที่พลังงาน 59.6 keV ตามลำดับ ซึ่งให้ประสิทธิภาพใกล้เกียงกับผลึก NaI(TI) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร หนา 25.4 มิลลิเมตร ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์

### 5.2 วิจารณ์ผลการวิจัย

5.2.1 สำหรับการปลูกผลึกอย่างง่ายการควบคุมแกรเดียนท์ของอุณหภูมิที่มีอัตรา เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อระยะทางต่ำให้มีความเป็นเชิงเส้นสูง จะต้องออกแบบให้มีการเกิดช่อง อากาศ (Air channel) ระหว่างแบบเฟิลกับท่อปลูกผลึกให้น้อย เพื่อรักษาความเสถียรของอุณหภูมิ บริเวณโซนปลูกผลึก อาจจะใช้ระบบแบริง (Bearing) ที่ทนอุณหภูมิสูง ประกอบกับท่อปลูกผลึก เพื่อลดช่องว่างระหว่างท่อปลูกผลึกกับแบฟเฟิล ในกรณีของระบบท่อปลูกผลึกแบบปีด

5.2.2 จากข้อมูลในการปลูกผลึกในสภาพของภาชนะปลูกผลึกแบบเปิดในท่อปลูกผลึก ระบบปิด พบว่า TII มีจุดหลอมตัวที่อุณหภูมิ 440°C ซึ่งต่ำกว่า CsI ถึง 181°C ทำให้เกิดปัญหาการ ระเหยออกจากผิวหน้าของ CsI ในกระบวนการปลูกผลึก มีผลให้ยีลด์ (Yield) ของสารเจือทัลเลียม อยู่ในเนื้อผลึกประมาณ 17% แม้ว่าความดันบรรยากาศภายในท่อปลูกผลึกจะสูงถึง 2 บรรยากาศ และใช้กราไฟต์เป็นจุกปิดภาชนะปลูกผลึกไว้ ปัญหาของการระเหยของสารเจืออาจมีความ จำเป็นต้องออกแบบภาชนะปลูกผลึกเป็นแบบปิดสนิท โดยคำนวณปริมาตรของภาชนะปลูกผลึก ให้เพียงพอต่อการรวมตัวของสาร เมื่อเกิดการหลอมเหลวหลังจากบรรจุสารเริ่มต้น สูบอากาศออก แล้วใช้กระบวนการเป่าแก้วปิดผลึกภาชนะปลูกผลึก ซึ่งนอกจากจะช่วยไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย สูญเสียสารที่ต้องการเจือในผลึกแล้ว อาจจะช่วยให้เกิดกระบวนการแพร่ของสารเจือในสภาพไอ ของสารสู่ผลึกได้เพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวสม่ำเสมอมากขึ้น

5.2.3 การนำภาชนะปลูกผลึกกลับมาใช้ใหม่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณา 2 ประการ คือ การ ปล่อยให้ผลึกเย็นตัว (Cooling down) อย่างช้าๆ จะทำให้ผลึกไม่ติดกับผนังภาชนะปลูกผลึก ทำให้ นำผลึกออกจากภาชนะได้ง่าย และการนำภาชนะกลับไปปลูกผลึกใหม่จะต้องทำความสะอาดด้วย เครื่องทำความสะอาดอุลตราโซนิค เนื่องจากมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ผนังของภาชนะปลูกผลึก จะทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างผลึก

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ในงานวิจัยขั้นต่อไปมีปัจจัยที่น่าสนใจศึกษาเพื่อควบคุมกระบวนการปลูกผลึกอย่าง ง่ายให้ได้ผลึก CsI(TI) ที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ ความสม่ำเสมอของการกระจายตัวของสารเจือทัลเลียม ในผลึก ความบกพร่องที่เกิดขึ้นในผลึก การเพิ่มยีลด์ (Yield) ของสารเจือทัลเลียมในกระบวนการ ปลูกผลึก เป็นต้น 5.3.2 เนื่องจากราคาของสารเริ่มต้นหลัก CsI ระหว่างความบริสุทธิ์ 99.9% และ 99.999% ต่างกันมาก จึงน่าจะมีการศึกษาการใช้สารเริ่มต้นหลักในการพัฒนาผลึกว่าให้ผลแตกต่างกันมาก น้อยเพียงใดในแง่มุมของความประหยัดและคุณภาพของผลึก เป็นต้น



# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

- DR Vij. <u>Thermoluminescent Materials</u>. Department of Physics. Kurukshetra University. India: PTR Prentice Hall, 1993.
- J.J Gilman. <u>The Art and Science of Growing Crystal</u>. Division of Engineering Brown University, 1963.
- วิญญู สกุลจริยาพร. <u>การพัฒนาหัววัครั้งสีซีเซียมไอโอไคค์ร่วมกับไคโอค p-i-n สำหรับตรวจวัค</u> <u>รังสีเอกซ์</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- William F.Smith. <u>PRINCIPLES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING</u>. Professor of Engineering University of Central Florida. USA: McGraw-Hill, Inc., 1996.
- Christine A. Wang. <u>CRYSTAL GROWTH AND SEGREGATION IN VERTICAL</u> <u>BRIDGMAN CONFIGURATION</u>. Doctor of Philosophy Thesis. Department of Material Science and Engineering. MIT,1984.
- J.B BRIKS. <u>The Theory and Practice of Scintillation Counting</u>. Reader in Physics. The University of Manchester. New York: Pergamon Press, 1964.
- William J.Price. <u>Nuclear Radiation Detection</u>. Executive Director Air Force Office of Scientific Research Office of Aerospace Research: USAF, 1962.
- Nicholas Tsoulfanidis. <u>Measurement and Detection of Radiation</u>. University of Missouri-Rolla. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1983.
- 9. Harmamatsu. Photodiode. Harmamatsu Phonics K.K., Solid state division. Japan, 1996.
- คุสิต เครื่องาม. สิ่งประคิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีและการใช้งาน. ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- Glenn F.Knoll. <u>Radiation Detection and Measurement</u>. Professor of Nuclear Engineering the University of Michigan: Ann Arbor. Michigan, 1989.

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
### ภาคผนวก ก.

# แสดงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

### Material Safety Data Sheet acc. to OSHA and ANSI

Printing date 07/15/2002

Reviewed on 04/30/1999



acc. to OSHA and ANSI

Printing date 07/15/2002

Reviewed on 04/30/1999

(Contd. of page 1)

Trade name: Cesium iodide

Wear fully protective impervious suit.

### 6 Accidental release measures

Person-related safety precautions: Wear protective equipment. Keep unprotected persons away. Ensure adequate ventilation Neasures for environmental protection: Do not allow material to be released to the environment without proper governmental permits. Neasures for cleaning/collecting: Pick up mechanically. Additional information: See Section 7 for information on safe handling See Section 8 for information on personal protection equipment. See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

### Handling

Information for safe handling: Keep container tightly sealed. Store in cool, dry place in tightly closed containers. No special precautions are necessary if used correctly. Information about protection against explosions and fires: No special measures required.

### Storage

Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements. Information about storage in one common storage facility: Not required. Further information about storage conditions: Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.

### 8 Exposure controls and personal protection

Additional information about design of technical systems: Properly operating chemical fume hood designed for hazardous chemicals and having an average face velocity of at least 100 feet per minute. Components with limit values that require monitoring at the workplace: Not required. Additional information: No data

Personal protective equipment General protective and hygienic measures The usual precautionary measures for handling chemicals should be followed. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Remove all soiled and contaminated clothing immediately. Wash hands before breaks and at the end of work.

(Contd. on page 3)

acc. to OSHA and ANSI Reviewed on 06/07/1999 Printing date 07/15/2002 1 Identification of substance: Product details: Trade name: Thallium (I) iodide Stock number: 11825 Manufacturer/Supplier: Alfa Aesar, A Johnson Matthey company Johnson Matthey Catalog Company, Inc. 30 Bond Street Ward Hill, MA 01835-8099 Emergency Phone: (978) 521-6300 CHEMTREC: (800) 424-9300 Web Site: www.alfa.com Information department: Health, Safety and Environmental Department Emergency information: During normal hours the Health, Safety and Environmental Department. After normal hours call Chemtrec at (800) 424-9300. 2 Composition/Data on components: Chemical characterisation: Description: (CAS#) Thallium (I) iodide (CAS# 7790-30-9), 100% Identification number(s): EINECS Number: 232-199-7 EU Number: 081-002-00-9 3 Hazards identification Hazard description; 30 T+ Very toxic Information pertaining to particular dangers for man and environment R 26/28 Very toxic by inhalation and if swallowed. Danger of cumulative effects. R 33 4 First aid measures General information Immediately remove any clothing soiled by the product. Remove breathing apparatus only after contaminated clothing has been completely removed. In case of irregular breathing or respiratory arrest provide artificial respiration. After inhalation Supply fresh air. If required, provide artificial respiration. Reep patient warm. Seek immediate medical advice. After skin contact Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly. Seek immediate medical advice. (Costd. on page 2)

acc. to OSHA and ANSI

Printing date 07/15/2002 Reviewed on 06/07/1999 Trade name: Thallium (I) iodide (Contd. of page 1) After eye contact Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor. After swallowing Do not induce vomiting; immediately call for medical help. Seek immediate medical advice. 5 Fire fighting measures Suitable extinguishing agents Product is not flammable. Use fire fighting measures that suit the surrounding fire. Special hazards caused by the material, its products of combustion or resulting gases: In case of fire, the following can be released: Toxic metal oxide fume Hydrogen iodide (HI) Protective equipment: Wear self-contained respirator. Wear fully protective impervious suit. 6 Accidental release measures Person-related safety precautions: Wear protective equipment. Keep unprotected persons away. Ensure adequate ventilation Measures for environmental protection: Do not allow material to be released to the environment without proper governmental permits. Measures for cleaning/collecting: Dispose contaminated material as waste according to item 13. Ensure adequate ventilation. Additional information: See Section 7 for information on safe handling See Section 8 for information on personal protection equipment. See Section 13 for disposal information. 7 Handling and storage Handling Information for safe handling: Keep container tightly sealed. Store in cool, dry place in tightly closed containers. Ensure good ventilation at the workplace. Open and handle container with care. Information about protection against explosions and fires: The product is not flammable Storage Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements. Information about storage in one common storage facility: Store in the dark. (Contd. on page 3)

acc. to OSHA and ANSI

Printing date 07/15/2002

Reviewed on 06/07/1999

(Contd. of page 2)

Trade name: Thallium (I) iodide

Purther information about storage conditions: Keep container tightly sealed.

Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Protect from exposure to light. Store under lock and key and with access restricted to technical experts or their assistants only.

# 8 Exposure controls and personal protection

Additional information about design of technical systems: Properly operating chemical fume hood designed for hazardous chemicals and having an average face velocity of at least 100 feet per minute.

# Components with limit values that require monitoring at the workplace:

Thallium and soluble thallium compounds (as T1)

	mg/m	3
ACGIH TLV	0.1	(skin)
Austria MAK	0.1	
Belgium TWA	0.1	(skin)
Denmark TWA	0.1	(skin)
Finland TWA	0.1	(skin)
France VME	0.2	
Germany MAK	0.1	
Ireland TWA	0.1	(skin)
Korea TLV	0.1	(skin)
Netherlands MAC-TGG	0.1	(skin)
Norway TWA	0.1	
Poland TWA	0.1.	, 0.3-STE
Switzerland MAK-W	0.1	(skin)
United Kingdom LTEL	0.1	(skin)
USA PEL	0.1	(skin)
Additional informat:	ion: 1	No data

### Personal protective equipment

General protective and hygienic measures The usual precautionary measures for handling chemicals should be followed. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Remove all soiled and contaminated clothing immediately. Wash hands before breaks and at the end of work. Store protective clothing separately. Breathing equipment: Use suitable respirator when high concentrations are present. Protection of hands: Impervious gloves Eye protection: Safety glasses

Body protection: Protective work clothing.

# ภาคผนวก ข.

# คุณสมบัติของซีเซียมไอโอไดด์

CsI								
Caesium Iodide								
Description								
The material with the deepest known IR tra	nsmission, CsI is sometimes							
used for components in the widest ran	ge spectrophotometers. An							
extremely soft material it is extremely	extremely soft material it is extremely difficult to polish and so							
performance is compromised for range. Dop	ed with thallium, CsI(Tl) is a							
useful scintillator which emits at a waveleng	th which is a good match for							
silicon photodiodes. Arrays of this material	are used in security imaging							
systems.								
Properties								
Apparent Elastic Limit (MPa)	5.6 (810psi)							
Bulk Modulus (K) (GPa)	12.67							
Cleavage Planes	None							
Decay Constant (µs)	0.03 & 0.1							
Density (g/cm ⁻³ )	4.51							
Dielectric Constant	5.65 at 1MHz							
Elastic Coefficient C11	24.6							
Elastic Coefficient C12	6.7							
Elastic Coefficient C44	6.24							
Emission Spectral Range (nm)	250 to 500							
Hardness (knoop) (100) direction	20.0							
Melting Point ( [°] C)	621							
Molecular Weight	259.83							
Peak Scintillation Wavelength (nm)	310							
Photons/MeV	16,800							

Poisson Ratio	0.214
Radiation Length (cm)	1.86
Reflection Loss (%)	13.6 at 119 (2 surfaces)
Refractive Index	1.78 at 10°C
Shear Modulus (G) (GPa)	6.24
Solubility (g/100g H ₂ O)	44.0 at 273K
Specific Heat Capacity (J.kg.m ⁻¹ .K ⁻¹ )	201
Stability	Deliquescent
Structure	Cubic
Temperature Coefficient of Light Output (%.K ⁻¹ )	-0.53
Thermal Conductivity (W.m ⁻¹ .K ⁻¹ )	1.1 at 298K
Thermal Expansion (K ⁻¹ )	48.3 X 10 ⁻⁶ at 293K
Transmission Range (🕅)	0.25 to 55.0
Youngs Modulus (E) (GPa)	5.3

	CsI(Tl)									
	Thallium doped Caesium Iodide									
	Properties									
	After Glow	Approx 2.0% after 2ms								
	After Glow	Approx 2.8% after 1ms								
	Cleavage Planes	None								
	Decay Constant (µs)	1.0								
ລາ	Density (g.cm ⁻³ )	4.51								
	Dielectric Constant	5.65 at 1MHz (298K)								
	Emission Spectral Range (nm)	375 to 725								
	Gamma and X-ray absorption	0.48  of  660  to  V								
	coefficients (cm ⁻¹ )	0.48 at 660ke v								
	Gamma and X-ray absorption	10.00 at 100keV								
	coefficients (cm ⁻¹ )	10.00 at 100keV								

Light Escape Cone to Air (°)	34.1				
Light Escape Cone to Glass ( [°] )	57.2				
Light Escape from one face to Air (%)	8.6%				
Light Escape from one face to Glass (%)	22.9%				
Melting Point ( [°] C)	621				
Optical Transmission Range	240nm to $70^{\circ}$ C				
Peak Scintillation Wavelength (nm)	565				
Photons/MeV	52,000				
Radiation Length (cm)	1.86				
Refractive Index at peak emission	1.78				
Soluble in Alcohol	Yes				
Specific Heat (J.kg ⁻¹ .K ⁻¹ )	0.048				
Stability	Slightly Hygroscopic				
Structure	BCC				
Temperature Coefficient of	10.22				
Light Output (%. [°] C ⁻¹ )	+0.32				
Thermal Conductivity (W.m ⁻¹ .K ⁻¹ )	1.13 at 298K				
Water Solubility (g/100ml H ₂ O)	44 at 273K				
Youngs Modulus (GPa)	5.3				

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ค.

# แสดงคุณสมบัติของขดลวดความร้อน

# Physical and Mechanical Properties KANTHAL Alloys

Heating Alloys	АРМ	A-1	А	AF	AE			
Max continuous operating temperature (element temperature in air), °C ° <i>F</i>	1425 <i>2595</i>	1400 <i>2550</i>	1350 <i>2460</i>	1300 <i>.2370</i>	1300 <i>2370</i>			
Nominal composition, % Cr Al Fe	5.	5.8 22 5.3 Balance						
Density, g/cm3 Ib/in3	7.10	.0.256		7.15 <i>0.258</i>				
Electrical resistivity at 20 °C, $\Omega$ mm ² m ⁻¹ at 68 °F, $\Omega/cmf$	1.45.	872		1.39 <i>836</i>				
Temperature factor of the resistivity, C, 250 °C 480 °F 500 °C 930 °F 800 °C 1470 °F 1000 °C 1830 °F 1200 °C 2190 °F	1./ 1./ 1./ 1./ 1./	00 01 03 04 04		1.01 1.03 1.05 1.06 1.06				
Coefficient of thermal expansion, K ⁴ 20-100°C         68-210°F           20- 250 °C         68- 480 °F           20- 500 °C         68- 930 °F           20- 750 °C         68-1380 °F           20-1000 °C         68-1830 °F	thermal expansion, K ⁻¹ 68-210 ⁻ F 68-480 ⁻ F 68-930 ⁻ F 68-1380 ⁻ F 68-1380 ⁻ F 12-10 ⁴ 68-1830 ⁻ F 15-10 ⁴							
Thermal conductivity at 50 °C, W m ⁻¹ K ⁻¹ 122 °F, Btu in ft ² h ⁻¹ °F ⁻¹	ACON IN	111112-12	1176					
Specific heat capacity, kJ kg ⁻¹ K ⁻¹ , 20 °C Btu lb ⁻¹ °F ⁻¹ , 68 °F		V	0.46 0.110					
Melting point (approx.), °C °F			15002730					
Mechanical properties *(approx.) Tensile strength, N mm ² psi	680 <i>98600**</i>	760110200	725105200	700101500	720104400			
Yield point, N mm ⁻² psi	47068200**	54579000	550 <i>798000</i>	50072500 52075400				
Hardness, Hv	230	240	230					
Elongation at rupture, %	20**	20	22	23	20			
Tensile strength at 900 °C, N mm ⁻² at 1650 °F, psi. Deformation rate 6.2 x 10 ⁻² min ⁻¹	40 5800	4	34 37 34 4900 5400 4900					
Creep strength*** at 800 °C, N mm ² at 1470 °F, psi at 1000 °C, N mm ² at 1830 °F, psi at 1100 °C, N mm ² at 2010 °F, psi at 1200 °C, N mm ² at 2190 °F, psi	8.2 <i>1190</i> – – –	1.2. 0.5	170 570 –	0.7100 0.340	1.2 <i>170</i> - - -			
Magnetic properties		Magnetic (	Curie point approx. 6	00 °C <i>1100</i> ° <i>F)</i>				
Emissivity, fully oxidized condition	0.70							
* The values given apply for sizes of app	rox. 1.0 mm diamete	er 0.04 in						

**4.0 mm O. 16 in. Finer gauges have higher strength and hardness values while the corresponding values are lower for heavier gauges.
***Calculated from observed elongation in a Kanthal standard furnace test. 1 % elongation after 1000 hours.



To obtain resistance at working temperature multiply by the factor C_t in the following table:

°F	68	212	392	572	752	932	1112	1292	1472	1652	1832	2012	2192	2372
C,	1.00	1.00	1.01	1.01	1.02	1.03	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06

amete WG	er inch	Resistance at 68°F Ω/ft	in²/Ω at 68°F	Weight Ib/1000 ft	Surface area in²/ft	Cross sec- tional area in ² x 1000
0	0.324	0.00796	1530	255	12.2	82.4
1	0.300	0.00929	1220	219	11.3	70.7
2	0.276	0.0110	948	185	10.4	59.8
3	0.252	0.0132	722	154	9.50	49.9
4	0.232	0.0155	563	131	8.75	42.3
5	0.212	0.0186	430	109	7.99	35.3
6	0.192	0.0227	319	89.6	7.24	29.0
7	0.176	0.0270	246	75.3	6.64	24.3
8	0.160	0.0327	185	62.2	6.03	20.1
9	0.144	0.0403	135	50.4	5.43	16.3
10	0.128	0.0510	94.6	39.8	4.83	12.9
11	0.116	0.0621	70.4	32.7	4.37	10.6
12	0.104	0.0773	50.7	26.3	3.92	8.49
13 (	0.0920	0.0988	35.1	20.6	3.47	6.65
14 (	0.0800	0.131	23.1	15.6	3.02	5.03
15 (	0.0720	0.161	16.8	12.6	2.71	4.07
16 (	0.0640	0.204	11.8	10.0	2.41	3.22
17 (	0.0560	0.267	7.92	7.63	2.11	2.46
18 (	0.0480	0.363	4.99	5.60	1.81	1.81
19 (	0.0400	0.523	2.89	3.89	1.51	1.26
20 (	0.0360	0.645	2.10	3.15	1.36	1.02
21 (	0.0320	0.816	1.48	2.49	1.21	0.804
22 (	0.0280	1.07	0.990	1.91	1.06	0.616
23 (	0.0240	1.45	0.623	1.40	0.905	0.452
24 (	0.0220	1.73	0.480	1.18	0.829	0.380
25 (	0.0200	2.09	0.361	0.973	0.754	0.314
26 (	0.0180	2.58	0.263	0.788	0.679	0.254
27 (	0.0164	3.11	0.199	0.654	0.618	0.211
28 (	0.0148	3.82	0.146	0.533	0.558	0.172
29 (	0.0136	4.52	0.113	0.450	0.513	0.145
30 (	0.0124	5.44	0.0860	0.374	0.467	0.121
31 (	0.0116	6.21	0.0704	0.327	0.437	0.106
32 (	0.0108	7.17	0.0568	0.284	0.407	0.0916
33 (	0.0100	8.36	0.0451	0.243	0.377	0.0785
34 ()	.00920	9.88	0.0351	0.206	0.347	0.0665
35 ()	.00840	11.8	0.0267	0.172	0.317	0.0554
36 0.	.00760	14.5	0.0198	0.140	0.287	0.0454
37 0.	.00680	18.1	0.0142	0.112	0.256	0.0363
38 0.	.00600	23.2	0.00974	0.0875	0.226	0.0283
39 0.	.00520	30.9	0.00634	0.0658	0.196	0.0212
40 0.	.00480	36.3	0.00499	0.0560	0.181	0.0181
41 0.	.00440	43.2	0.00384	0.0471	0.166	0.0152
42 0.	.00400	52.3	0.00289	0.0389	0.151	0.0126
43 0.	.00360	64.5	0.00210	0.0315	0.136	0.0102
44 0.	.00320	81.6	0.00148	0.0249	0.121	0.00804
45 0.	.00280	107	0.000990	0.0191	0.106	0.00616
46 0.	.00240	145	0.000623	0.0140	0.0905	0.00452
47 0.	.00200	209	0.000361	0.00973	0.0754	0.00314
48 0.	.00160	327	0.000185	0.00622	0.0603	0.00201



Resistivity Ω/sq.mil ft 657 Density, lb/cu.in 0.258	in²/Ω
--------------------------------------------------------	-------

 $2 = \frac{l^2 C_t}{p} \qquad \begin{array}{c} l & = Current \\ C_t & = Temperature factor \\ p & = Surface load W/in^2 \end{array}$ 

To obtain resistance at working temperature multiply by the factor  $C_t$  in the following table:

۴F	68	212	392	572	752	932	1112	1292	1472	1652	1832	2012	2192	2372
C,	1.00	1.00	1.01	1.01	1.02	1.03	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06

Width	Thickness	Resistance	in²/Ω	Weight	Surface	Cross sec-	Width	Thickness	Resistance	in²/Ω	Weight	Surface	Cross sec-
in	in	at 68°⊦ Ω/ft	at 68°⊦	lb/1000 ft	area in²/ft	tional area in ² x 1000	in	in	at 68°⊢ Ω/ft	at 68°F	lb/1000 ft	area in²/ft	tional area in ² x 1000
1/8	0.057	0.100	43.6	20.3	4.37	6.56		-					
	0.051	0.112	37.7	18.2	4.22	5.87							
	0.045	0.127	32.2	16.0	4.08	5.18	3/64	0.029	0.525	3.47	3.87	1.82	1.25
	0.040	0.143	27.7	14.2	3.96	4.60		0.025	0.609	2.83	3.34	1.73	1.08
	0.036	0.159	24.4	12.8	3.86	4.14		0.023	0.662	2.53	3.07	1.68	0.992
	0.032	0.1/8	21.1	11.4	3.77	3.08		0.020	0.701	2.11	2.07	1.01	0.863
	0.029	0.197	10.0	0.0	3.70	0.04		0.016	0.040	1.04	2.40	1.00	0.770
	0.025	0.228	14.3	8.90	3.60	2.88		0.016	1.00	1.59	2.14	1.01	0.690
	0.020	0.240	12.0	7.12	3.49	2.00		0.013	1.05	1.04	1.07	1.40	0.004
	0.020	0.317	10.8	6.41	3.43	2.00		0.013	1.38	1.20	1.74	1.39	0.001
	0.016	0.357	9.48	5.70	3.38	1.84		0.010	1.52	0.896	1.34	1.37	0.431
	0.014	0.408	8.18	4.98	3.34	1.61		0.0089	1.71	0.782	1.19	1.34	0.384
	0.013	0.439	7.54	4.63	3.31	1.50		0.0080	1.90	0.692	1.07	1.32	0.345
	0.011	0.519	6.29	3.92	3.26	1.27		0.0071	2.14	0.604	0.948	1.30	0.306
	0.010	0.571	5.67	3.56	3.24	1.15	1	0.0063	2.42	0.528	0.841	1.28	0.272
	0.0089	0.642	5.01	3.17	3.21	1.02		0.0056	2.72	0.463	0.748	1.26	0.242
	0.0080	0.714	4.47	2.85	3.19	0.920		0.0050	3.05	0.409	0.668	1.25	0.216
	0.0071	0.804	3.94	2.53	3.17	0.817		0.0045	3.38	0.364	0.601	1.23	0.194
	0.0063	0.906	3.48	2.24	3.15	0.725		0.0040	3.81	0.321	0.534	1.22	0.173
						10100		0.0035	4.35	0.278	0.467	1.21	0.151
3/32	0.057	0.134	27.1	15.2	3.62	4.92		0.0031	4.91	0.244	0.414	1.20	0.134
	0.051	0.149	23.3	13.6	3.47	4.40	4/00	0.040	4.40	0.704	4.40	4.40	0.400
	0.045	0.169	19.7	12.0	3.33	3.88	1/32	0.016	1.43	0.794	1.42	1.13	0.460
	0.040	0.190	14.7	10.7	3.21	3.40		0.014	1.00	0.000	1.20	1.09	0.403
	0.030	0.238	12.7	8.54	3.02	2.76		0.013	2.08	0.004	0 979	1.00	0.316
	0.002	0.263	11.2	7.74	2.95	2.70	1	0.010	2.00	0.400	0.890	0 990	0.288
	0.025	0.305	9.36	6.68	2.85	2.16	1	0.0089	2.57	0.375	0.792	0.964	0.256
	0.023	0.331	8.46	6.14	2.80	1.98		0.0080	2.86	0.330	0.712	0.942	0.230
	0.020	0.381	7.17	5.34	2.73	1.73		0.0071	3.22	0.286	0.632	0.920	0.204
	0.018	0.423	6.34	4.81	2.68	1.55		0.0063	3.63	0.249	0.561	0.901	0.181
	0.016	0.476	5.54	4.27	2.63	1.38		0.0056	4.08	0.217	0.498	0.884	0.161
	0.014	0.544	4.76	3.74	2.59	1.21		0.0050	4.57	0.190	0.445	0.870	0.144
	0.013	0.586	4.37	3.47	2.56	1.12		0.0045	5.08	0.169	0.401	0.858	0.129
	0.011	0.692	3.63	2.94	2.51	0.949		0.0040	5.71	0.148	0.356	0.846	0.115
	0.010	0.761	3.27	2.67	2.49	0.863		0.0035	6.53	0.128	0.312	0.834	0.101
	0.0089	0.855	2.88	2.38	2.46	0.768		0.0031	7.37	0.112	0.276	0.824	0.0891
	0.0080	0.952	2.0/	2.14	2.44	0.690		0.0028	8.10	0.100	0.249	0.817	0.0805
	0.0071	1.07	1.00	1.90	2.42	0.612	0	0.0025	9.14	0.0007	0.223	0.010	0.0719
	0.0005	1.21	1.55	1.00	2.40	0.040		0.0022	10.4	0.0773	0.150	0.003	0.0000
	0.0050	1.52	1.56	1.34	2.37	0.431	1/64	0.0089	5 13	0 115	0.396	0.589	0 128
								0.0080	5.71	0 0993	0.356	0.567	0.115
1/16	0.032	0.357	6.35	5.70	2.27	1.84		0.0071	6.43	0.0848	0.316	0.545	0.102
	0.029	0.394	5.58	5.16	2.20	1.67		0.0063	7.25	0.0726	0.280	0.526	0.0906
0	0.025	0.457	4.60	4.45	2.10	1.44		0.0056	8.16	0.0624	0.249	0.509	0.0805
	0.023	0.497	4.13	4.09	2.05	1.32		0.0050	9.14	0.0542	0.223	0.495	0.0719
- C	0.020	0.571	3.47	3.56	1.98	1.15		0.0045	10.2	0.0476	0.200	0.483	0.0647
	0.018	0.634	3.04	3.20	1.93	1.04		0.0040	11.4	0.0412	0.178	0.471	0.0575
	0.016	0.714	2.64	2.85	1.88	0.920		0.0035	13.1	0.0352	0.156	0.459	0.0503
	0.014	0.816	2.25	2.49	1.84	0.805		0.0031	14.7	0.0305	0.138	0.449	0.0446
	0.013	0.879	2.06	2.31	1.81	0.748		0.0028	16.3	0.0271	0.125	0.442	0.0403
	0.011	1.04	1.70	1.90	1.70	0.633		0.0025	18.3	0.0238	0.0070	0.435	0.0309
	0.010	1.14	1.02	1.70	1.74	0.575		0.0022	20.0	0.0200	0.0979	0.420	0.0310
	0.0089	1.20	1 19	1.00	1.69	0.012							
	0.0071	1.45	1.04	1.42	1.67	0.400							
	0.0063	1.81	0.911	1 12	1.65	0.362							
	0.0056	2.04	0.801	0.997	1.63	0.322							
	0.0050	2.28	0.709	0.890	1.62	0.288							
	0.0045	2.54	0.634	0.801	1.61	0.259							
	0.0040	2.86	0.559	0.712	1.60	0.230							

# ภาคผนวก ง.

# แสดงคุณสมบัติของอิฐทนไฟ

Duonoutios Tuno	INSULATING FIREBRICK					
Properties Type	C. 1	C. 2				
Maximum Service	1200	1400				
Temperature (0°C)	1300	1400				
Bulk Density G/Cm ³	1.06	1.14				
Thermal Conductivity	0.28	0.32				
K Cal/mh C at 300°C (Mean)						
Rehead shrinkage	0.57	0.59				
% at ( ) C x 8 hrs	(1300)	(1400)				
Cold Srushing		79				
Strength Kg/Cm ²	03	/8				
Modulus of Rupture (Kg/cm.)	25	32				
Thermal Expansion	0.51	0.49				
% at ( ) °C	(1000)	(1000)				
Chemical Composition %						
AL2 O3	30	35				
Si O2	65	61				
Fe2 O3	1.8	1.6				
Raw material	Fire	clay				
จุพาดงการเหมา	NIJNE	เดย				

## ภาคผนวก จ.

# แสดงข้อมูลอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดี



# เครื่องวัตและควบคุมอุณหภูมิระบบ FUZZY + PID FUZZY + PID TEMPERATURE CONTROLLER

# 📕 ฟังก์ชันพิเศษ

สามารถตั้งการควบคุมแบบความขัน (Ramp) ได้เป็นองศา/นาที เพื่อป้องกันการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิที่รวดเร็วเกินไป ซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อ ขึ้นงานบางประเภทได้ (Soft Start)

สามารถเลือกการทำงานของ Alarm ให้เป็น Timer ได้ (Dwell Timer) และตั้งค่า Dwell Time ในหน่วยนาที โดย Timer จะเริ่มจับเวลา เมื่ออุณหภูมิถึงค่า Setpoint และ Alarm Relay จะเปลี่ยนสถานะเป็น ON หรือ OFF ตามที่กำหนดไว้เมื่อครบเวลา Dwell Time ฟังก์ขันนี้ ประยุกต์ใช้ได้ในงานต่าง ๆ เช่น ให้ Alarm Relay สังงานกระบวนการต่อ ไปหลังจากควบคุมอุณหภูมิครบเวลาที่กำหนด หรือต่อให้ออดดังเพื่อนำขึ้น งานออก เมื่ออบจนได้ที่ รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ขัน Ramp ได้ด้วย

■ สามารถเลือกให้ Parameter บางตัวอยู่ในระดับ User ได้ (ดูหรือ แก้ไบค่าได้โดยกดปุ่มเดียว) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปใน ใปรแกรมทุกครั้ง



อินพุด	เทอร์มอคัปเปิล อาร์ทีดี Linear	Type J, K, T, E, B, R, S, N Pt100 Ohm RTD (DIN/JIS) 4-20mA, 0-1V, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 1-10V	Accuracy ± 2 °C Accuracy ± 0.4 °C Accuracy ± 0.05 %
เอาต์พุต	รีเลย์ พัลส์สำหรับ SSR กระแสบาตรจาน	5A/240VAC Resistive 20mA/24VDC 4-20mA_mox_load_500 โอห์ม	)
	Alarm รีเลย์	2A/240VAC Resistive	
<u>าารควบคุม</u>	Proportional Band Integral Time Derivative Time Ramp Rate (ความขั้น) Dwell Time (หน่วงเวลา) Hysteresis (ON-OFF) Cycle Time Control Action รูปแบบการควบคุม	0-200 °C (0-360 °F) 0-3600 วินาที 0-1000 วินาที 0-200.0 °C/นาที (0-360.0 °F/นาที) 0-3600 นาที 0-20% ของช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0-120 วินาที Direct (Cooling) /Reverse (Heating) ON-OFF, P, PI, PD, Fuzzy + PID	ว
Power	ไฟเลี้ยง Consumption	90-264VAC, 50/60Hz น้อยกว่า 5 VA	
ทั่วไป	อุณหภูมิใช้งาน ความขึ้นใช้งาน	-10 ถึง 50°C 0 - 90% RH	

# 📕 คุณสมบัติทางเทคนิค

# ภาคผนวก ฉ.

# แสดงข้อมูลทางเทคนิคของพินโฟโตไดโอด



### General ratings / Absolute maximum ratings

Good energy resolution

			Absolute maximum ratings						
Type No.	Window material	Active area (mm)	Reverse voltage Vr Max.	Power dissipation P (mW)	Operating temperature Topr (°C)	Storage temperature Tstg (°C)			
S3590-01	Epoxy resin	$10 \times 10$	50			-20 to +80			
S3590-02	Window-less	10 ~ 10	50		20 to +60				
S3590-05	Epoxy resin	0 ~ 0	150	100					
S3590-06	Window-less	9 ~ 9	150	100	-20 10 +00				
S3590-08	Epoxy resin	10 + 10	100						
S3590-09	Window-less	10 * 10	100	ธฏกร					

# Electrical and optical characteristics (Typ. Ta=25 °C, unless otherwise noted)

ລາ	Spectral Po response sens	Peak sensitivity	eak Photo sensitivity sitivity S			Short circuit current	Da cur I	ark rent D	Temp.	Cut-off	Terminal capacitance	NEP		
Type No.	range λ	wavelength λp	λ=λp	LSO	BGO	CsI(TI)	lsc 100 <i>Ix</i>	Тур.	Max.	of ID TCID	Frequency fc	Ct f= 1MHz	Vr=70 V	
	(nm)	(nm)	(A/W)	420 nm (A/W)	480 nm (A/W)	540 nm (A/W)	(µA)	(nA)	(nA)	(times/⁰C)	(MHz)	(pF)	(W/Hz ^{1/2} )	
S3590-01	320 to	920	0.58	0.19	0.26	0.31	80	1.5 *1	1 = *1	*1 = *1		25 ×1	75 *1	2 0 - 10 - 14
S3590-02	1060		0.62	0.23	0.32	0.39			19	² 1.12	35 .	75	3.8 10	
S3590-05	320 to	980	0.62	0.19	0.25	0.30	77	8 *2	*2 30 *2		20 *2	25 +2	a 1 v 10-14	
S3590-06	1120		0.64	0.23	0.32	0.39						25 -	0.4 ^ 10	
S3590-08	320 to	960	0.66	0.20	0.30	0.36	100	2 *3	2 * ³ 6 * ³		40 *3	40 * ³	3.8 × 10 ⁻¹⁴	
S3590-09	1100		0.66	0.22	0.33	0.41	100							

*1: VR=30 V *2: VR=100 V

*3: VR=70 V

# Si PIN photodiode S3590 series



# ภาคผนวก ช.

# การวิเคราะห์ปริมาณแทลเลียมโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray Fluorescence)

ชื่อเครื่อง:	X-ray Fluorescence Spectrometer
ยี่ห้อ:	Oxford
รุ่น:	ED2000

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์<mark>:</mark>

1. MODE	Vacuum Mode
2. Tube Voltage	50 kV
3. Filter	Thick Cu
4. Pulse Rate	16 kcps
5. Warmup Time	10 sec.
6. Upper Energy Limit	52 keV
7. Energy Rang	40 keV
8. Resolution	175 eV

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



# ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นาย มานิตย์ จิตรภักดี เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ที่จังหวัดพัทถุง สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2541 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2543



# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย